## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平11-143067

(43)公開日 平成11年(1999) 5月28日

(51) Int.CL <sup>6</sup>		識別記号	<b>F</b> I			
G03F	7/023	511	G 0 3 F	7/023	511	
	7/038	601		7/038	601	
	7/039	601		7/039	601	

		審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 48 頁)
(21)出願番号	<b>特顯平</b> 9-317697	(71)出顧人 000001270
(22)出顧日	平成9年(1997)11月4日	コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿 1 丁目26番 2 号
		(72)発明者 服部 良司
		東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式
		会社内
		(74)代理人 弁理士 坂口 信昭

## (54) 【発明の名称】 感光性組成物

#### (57)【要約】

【課題】耐薬品性向上、現像液ラチチュード性の向上及び高感度性を有する感光性組成物を提供する。

【解決手段】1)下記(1)~(3)からなるフェノール成分及びアルデヒド類又はケトン類を縮合させた樹脂であり、かつ、この樹脂の重水素化ジメチルスルホキシド溶液の1 3 C - NMRスペクトルにおいて、23.0

フェノール成分

- (1)フェノール類
- (2) m-アルキルフェノール類
- (3) pーアルキルフェノール類

~31.0ppmまでのピーク積分値をA、23.0~37.0ppmまでの積分値をB、とした場合に、X=A/Bの値がX≥0.6であることを特徴とするアルカリ可溶性樹脂、2)赤外光に吸収を有する染料、3)活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、4)酸により分解し得る結合部又は酸により架橋する基を有する化合物、からなる感光性組成物である。

0~50モル% 20~80モル% 20~80モル%

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】1) 下記(1)~(3) からなるフェノー ル成分及びアルデヒド類又はケトン類を縮合させた樹脂 であり、かつ、この樹脂の重水素化ジメチルスルホキシ ド溶液の1 3 C-NMRスペクトルにおいて、23.0 ~31. Oppmまでのピーク積分値をA、23. 0~\*

#### フェノール成分

- (1)フェノール類
- (2) m-アルキルフェノール類
- (3) p-アルキルフェノール類

【請求項2】前記フェノール成分を少なくとも一種含有 することを特徴とする請求項1記載の感光性組成物。

【請求項3】請求項1又は2記載のフェノール性樹脂の 分子量が500~5000であることを特徴とする感光 性組成物。

【請求項4】請求項1又は2記載の樹脂の分子量が20% 一般式 (1)

\* 37. 0ppmまでの積分値をB、とした場合に、X= A/Bの値がX≥0.6であることを特徴とするアルカ リ可溶性樹脂、2)赤外光に吸収を有する染料、3)活 性光線の照射により酸を発生し得る化合物、4)酸によ り分解し得る結合部又は酸により架橋する基を有する化 合物、からなる感光性組成物。

> 0~50モル% 20~80モル% 20~80モル%

※0~3000のノボラック樹脂と下記一般式 (1)で表 される化合物を含むフェノール類及びアルデヒド類又は ケトン類を縮合させた樹脂を含むことを特徴とする感光 件組成物。

【化1】

 $n \ge 1$ 

# X=アルキル基 (C<sub>1</sub>~C<sub>0</sub>)、アルキルエステルを意味する

【請求項5】1)アルカリ可溶性ノボラック樹脂と、上 記一般式(1)で表される化合物を含むフェノール類及 びアルデヒド類又はケトン類を縮合させて得られ、かつ 単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミェーショ ン、クロマトグラフ (GPC) 法により求めたポリスチ レン換算分子量が、6500~30000、1000~ 30 6000及び100~950の範囲にあるピークの最大 の高さをそれぞれa, b及びcとしたとき、a/b=0~1.5及びc/b=0.05~1.5の樹脂、2)赤 外光に吸収を有する染料、3)活性光線の照射により酸 を発生し得る化合物、4)酸により分解し得る結合部又 は酸により架橋する基を有する化合物からなる感光性組 成物。

【請求項6】1)アルカリ可溶性ノボラック樹脂とし て、上記一般式(1)で表される化合物を含むフェノー ル類及び芳香族アルデヒド類を縮合させて得られるノボ 40 有する記録材料が、広く知られている。 ラック樹脂、2)赤外光に吸収を有する染料、3)活性 光線の照射により酸を発生し得る化合物、4)酸により 分解し得る結合部又は酸により架橋する基を有する化合 物からなる感光性組成物。

【請求項7】請求項6記載のノボラック樹脂の分子量 が、300~2000の範囲であることを特徴とする 感光性組成物。

【請求項8】請求項6又は7記載のフェノール類の縮合 物として、サリチルアルデヒド又はベンズアルデヒドか らなることを特徴とする感光性組成物。

- ★【請求項9】1)ナフトールノボラック樹脂、2)赤外 光に吸収を有する染料、3)活性光線の照射により酸を 発生し得る化合物、4)酸により分解し得る結合部又は 酸により架橋する基を有する化合物からなる感光性組成
- 【請求項10】ナフトールノボラック樹脂の分子量が、 300~1000の範囲であることを特徴とする請求 項9記載の感光性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐薬品性向上、現 像液ラチチュード性の向上及び高感度性を有する感光性 組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】酸発生剤酸分解型化合物を含む感光層を

【0003】従来、酸分解化合物に着目した技術とし て、米国特許第3,779,778号にオルトカルボン 酸エステル基又はカルボン酸アミドアセタール基を有す る化合物が開示され、特開昭53-133429号に主 鎖にアセタール又はケタール結合を有する化合物が開示 され、特開昭60-37549号にシリルエーテル化合 物が開示されているが、いずれも紫外線により露光部が アルカリ可溶化し非画線部となるポジ型感光層を有する 記録材料である。

【0004】一方、米国特許第5,340,699号 ★50

に、酸発生剤とレゾール樹脂とノボラック樹脂と赤外線 吸収剤とを有する記録材料が開示されている。この技術 は赤外線、紫外線とも記録可能、露光部が硬化し現像液 に不溶化し画像部となるネガ型感光層を有する記録材料 である。

【0005】他方、特願平7-138519号に、高分 子量フェノール樹脂とO-キノンジアジド化合物と沸点 110℃以下の有機溶剤と120℃以上の有機溶剤から なる感光層を有する記録材料が開示されており、また、 米国特許第3,666,473号、同4,115,12 10 8号及び同4, 173, 470号公報にノボラック型フ ェノール樹脂及び/又はナフトキノンジアジド置換化合 物が開示されており、更に、「イントロダクション・ト ゥー・マイクロリソグラフィー」(ACS出版、No. 219号、p112~121) にクレゾールーホルムア ルデヒドよりなるノボラック樹脂及び/又はトリヒドロ キシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドス ルホン酸エステルが開示されているが、いずれも紫外線 により露光部がアルカリ可溶化し非画線部となるポジ型 感光層を有する記録材料である。

【0006】従来技術を本発明の請求項毎に整理すれ ば、次の通りである。

1)本発明の請求項1~3に関するハイオルソノボラッ ク樹脂の従来技術

ノボラック樹脂は、従来から様々改良が見られ、そのな かで、酸触媒による重縮合反応で合成されるノボラック に比べ、オルソーオルソ結合を多く含む、いわゆるハイ オルソノボラック樹脂といわれる樹脂が知られている。 この樹脂はフォトレジスト分野に使用され、ヶ値を高め る試みをしたり (特公平4-2181号公報)、高い感 30 度で広いデフォーカスラチチュードとスカムの発生しに くい感電離放射線性樹脂組成物(特開平3-25385 9号公報)、あるいは露光時の微細発泡によるパターン の欠陥が生じにくく、かつ、スカムによる微細欠陥も生 じにくいポジ型フォトレジスト組成物 (特開平3-25 3860号公報)、印刷版においては近年キノンジアジ ドとの組合せにより耐薬品性、高感度、硬調性を改善す ることができた (特開平8-184964号)。しかし ながらいずれも紫外線により画像形成を行っており簡便 さに欠けている。

2) 本発明の請求項4に関するタンデム型の従来技術 ノボラック樹脂は、従来から様々改良が見られ、そのな かで特公平6-54386号 (日本合成ゴム)では、タ\*

フェノール成分

- (1)フェノール類
- (2) m-アルキルフェノール類
- (3) p-アルキルフェノール類

【0009】2. 前記フェノール成分を少なくとも一種 含有することを特徴とする上記1記載の感光性組成物、

【0010】3. 上記1又は2記載のフェノール性樹脂※50 【0011】4. 上記1又は2記載の樹脂の分子量が2

- \*ンデム型のノボラック樹脂を使用し耐熱性と感度、現像 性に優れたフォトレジスト材料を提供した。しかし、い ずれも紫外線により露光部がアルカリ可溶化し非画線部 となる感光性平板印刷版かあるいはフォトレジストであ った。
  - 3) 本発明の請求項5~7に関する芳香族含有縮合物の 従来技術
- 1)、2)を含めた前記、記載のような感材が従来技術 である。他に特開平2-300752号、特開平6-2 42601号、米国特許第5,571,886号、同 5, 266, 440号、特開平8-234421号、特 開平9-90626号、特開平5-289331号、特 開平2-300751号、特開平8-211601号、 特開昭60-31138号、特開平8-272093号 等では、いずれも紫外線により露光部がアルカリ可溶化 し非画線部となる感光性平版印刷版かあるいはフォトレ ジストであった。
- 4) 本発明の請求項8に関するナフトールノボラック樹 脂の従来技術
- 20 1)、2)を含めた前記、記載のような感材が従来技術 である。他に特開平9-127691号では酸分解性基 を有する樹脂+光酸発生剤+分子量2000以下のナフ トールノボラック樹脂によるフォトレジストを作成して いるが、赤外光に吸収を有しないために本発明のレーザ ーでは使用不可能であった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、耐薬 品性向上、現像液ラチチュード性の向上及び高感度性を 有する感光性組成物を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の上記課題は、 1.1) 下記(1)~(3) からなるフェノール成分及

びアルデヒド類又はケトン類を縮合させた樹脂であり、 かつ、この樹脂の重水素化ジメチルスルホキシド溶液の 13 C-NMRスペクトルにおいて、23.0~31. Oppmまでのピーク積分値をA、23.0~37.0 ppmまでの積分値をB、とした場合に、X=A/Bの 値がX≥0.6であることを特徴とするアルカリ可溶性 樹脂、2)赤外光に吸収を有する染料、3)活性光線の 40 照射により酸を発生し得る化合物、4)酸により分解し 得る結合部又は酸により架橋する基を有する化合物、か らなる感光性組成物、

> 0~50モル% 20~80モル% 20~80モル%

※の分子量が500~5000であることを特徴とする感 光性組成物、

00~3000のノボラック樹脂と下記一般式 (1)で 表される化合物を含むフェノール類及びアルデヒド類又 はケトン類を縮合させた樹脂を含むことを特徴とする感\* 一般式 (1)

\* 光性組成物、 [0012] 【化2】

$$(OH)_{n} X$$

$$n \ge 1$$

# X=アルキル基 (C<sub>1</sub>~C<sub>9</sub>)、アルキルエステルを意味する

20

【0013】5.1)アルカリ可溶性ノボラック樹脂 と、上記一般式(1)で表される化合物を含むフェノー ル類及びアルデヒド類又はケトン類を縮合させて得ら れ、かつ単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミェ ーション、クロマトグラフ (GPC) 法により求めたポ リスチレン換算分子量が、6500~30000、10 00~6000及び100~950の範囲にあるピーク の最大の高さをそれぞれa、b及びcとしたとき、a/ b=0~1.5及びc/b=0.05~1.5の樹脂、 2) 赤外光に吸収を有する染料、3) 活性光線の照射に より酸を発生し得る化合物、4)酸により分解し得る結 合部又は酸により架橋する基を有する化合物からなる感 光性組成物、

【0014】6.1)アルカリ可溶性ノボラック樹脂と して、上記一般式(1)で表される化合物を含むフェノ ール類及び芳香族アルデヒド類を縮合させて得られるノ ボラック樹脂、2)赤外光に吸収を有する染料、3)活 性光線の照射により酸を発生し得る化合物、4)酸によ り分解し得る結合部又は酸により架橋する基を有する化 30 合物からなる感光性組成物、

【0015】7.上記6記載のノボラック樹脂の分子量 が、300~2000の範囲であることを特徴とする 感光性組成物、

【0016】8. 上記請求項6又は7記載のフェノール 類の縮合物として、サリチルアルデヒド又はベンズアル デヒドからなることを特徴とする感光性組成物、

【0017】9.1)ナフトールノボラック樹脂、2) 赤外光に吸収を有する染料、3)活性光線の照射により 酸を発生し得る化合物、4)酸により分解し得る結合部 又は酸により架橋する基を有する化合物からなる感光性 組成物、

【0018】10. ナフトールノボラック樹脂の分子量 が、300~1000の範囲であることを特徴とする 上記9記載の感光性組成物、の各々により達成される。 【0019】従来技術では紫外線による画像露光に限ら れていたが、本発明により赤外線露光による画像形成が 可能となった。すなわち従来技術は、一般的にマスクフ ィルム等を介してハロゲンランプ、高圧水銀灯などから ※ザー、ヘリウムーカドミウムレーザー等の短波長レーザ ーによる露光も可能であるが装置が高価で大きく、感材 の感度も十分でなかった。本発明では安価でコンパクト な半導体レーザー等による赤外線露光で画像形成可能で ある。又、これによってマスクフィルムとそれを作成す るプロセスや設備も必要なく、簡便にデジタル画像を形 成することが可能である。

【0020】従来までの赤外色素による画像形成された 感光性平版印刷版は、画像形成するものの現像液に対す るラチチュードすなわち現像液の濃度によって画像部が 膜ベリが起きてしまう現象が起きる (露光部の現像液耐 性が低いための現象)。又、上記とは別に露光部を薬品 (印刷時に使用する薬品)で浸すと感光層が薬品に膨潤 しやすいために膜ベリしてしまう。このように感材の膜 強度が低下してしまうことが従来まで問題であった。

【0021】しかし、本発明のような特定のノボラック 樹脂、その他の構成を使用することによって、改善する ことが解明された。

### [0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細について説明 する。本発明の赤外光に吸収を有する染料とは、シアニ ン系、アミニウム系、ジイモニウム系色素、金属錯体 系、ピリリウム系の色素があるが、好ましくは、シアニ ン系色素が好ましい。添加量は0.01~10重量% で、好ましくは0.1~5重量%である。

【0023】以下、赤外線染料ないし赤外線吸収剤につ いて詳述する。

【0024】本発明に用いられる赤外線染料ないし吸収 剤としては、波長700 nm以上に吸収を持つ赤外吸収 色素、カーボンブラック、磁性粉等を使用することがで きる。特に好ましい赤外線吸収剤は700~1100m mに吸収ピークを有し、ピークでのモル吸光係数 $\epsilon$ が1 05以上の赤外吸収色素である。

【0025】上記赤外吸収色素としては、シアニン系色 素、スクアリウム系色素、クロコニウム系色素、アズレ ニウム系色素、フタロシアニン系色素、ナフタロシアニ ン系色素、ポリメチン系色素、ナフトキノン系色素、チ オピリリウム系色素、ジチオール金属錯体系色素、アン 照射紫外線により画像露光を行っていた。アルゴンレー※50 トラキノン系色素、インドアニリン金属錯体系色素、分

子間CT色素等が挙げられる。上記赤外吸収色素としては、特開昭63-139191号、同64-33547号、特開平1-160683号、同1-280750号、同1-293342号、同2-2074号、同3-26593号、同3-30991号、同3-34891号、同3-36093号、同3-36094号、同3-36095号、同3-42281号、同3-10347\*-般式 (R-1)

\*6号等に記載の化合物が挙げられる。

【0026】本発明において、赤外線吸収剤として、下記一般式(R-1)又は(R-2)で表されるシアニン系色素が特に好ましい。

【0027】 【化3】

$$X_1$$
 $X_2$ 
 $X_3$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 
 $X_4$ 

一般式 (R-2)

$$X_1$$
 $R_0$ 
 $R_0$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_5$ 
 $R_6$ 

【0028】式中、Z1及びZ2は各々硫黄原子、セレン原子又は酸素原子を表し、X1及びX2は各々置換基を有していてもよいベンゾ縮合環又はナフト縮合環を形成するのに必要な非金属原子群を表し、R3及びR4は各々置換基を表し、R3及びR4のどちらか一方はアニオン性解離性基を有する。R5、R6、R7及びR8は各々炭素原子数1~3のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。Lは炭素原子数5~13の共役結合の連鎖を表す。

【0029】一般式 (R-1) 又は (R-2) で表されるシアニン系色素は、一般式 (R-1) 又は (R-2) がカチオンを形成し、対アニオンを有するものを包含する。この場合、対アニオンとしては、C1-、Br-、C104-、BF4-、t-ブチルトリフェニルホウ素等のアルキルホウ素等が挙げられる。

【0030】一般式(R-1)及び(R-2)において、Lで表される共役結合の連鎖の炭素原子数(n)は、画像露光の光源として赤外線を放射するレーザーが使用される場合、該レーザーの発信波長に合わせて有効 40な値を選択することが好ましい。例えば、発信波長1060nmのYAGレーザーを使用する場合は、nは9~13が好ましい。又、この共役結合部分は任意の置換基を有することができ、又共役結合部分は複数の置換基により環を形成させてもよい。又、X1で表される環及びX2で表される環には任意の置換基を有することができる。該置換基としてハロゲン原子、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数1~5のアルコキシ基、-SO※

※3 M及び-COOM (Mは水素原子又はアルカリ金属原子)から選ばれる基が好ましい。R3 及びR4 は各々任意の置換基であるが、好ましくは炭素原子数1~5のアルキル基もしくは炭素原子数1~5のアルコキシ基;-((CH2)n-O-)k-(CH2)mOR(n及びmは各々1~3の整数、kは0又は1、Rは炭素原子数1~5のアルキル基を表す。);R3 及びR4 の一方が-R-SO3 Mで他方が-R-SO3-(Rは炭素原子数1~5のアルキル基を表す。)

 対1~5のアルキル基、Mはアルカリ金属原子を表す。);又はR3及びR4の一方が-R-COOMで他方が-R-COOMで他方が-R-COO-(Rは炭素原子数1~5のアルキル基、Mはアルカリ金属原子を表す。)である。R3及びR4は、感度及び現像性の点から、R3及びR4の一方が上記-R-SO3-又は-R-COO-、他方が上記-R-SO3 M又は-R-COOMであることが好ましい。

【0031】一般式(R-1)又は(R-2)で表されるシアニン系色素は、画像露光の光源として半導体レー0 ザーを使用する場合は750~900nm、YAGレーザーを使用する場合は900~1200nmにおいて吸収ピークを示し、ε>1×105のモル吸光係数を有するものが好ましい。

【0032】本発明に好ましく用いられる赤外線吸収剤 の代表的具体例を以下に挙げるが、これらに限定される ものではない。

[0033]

【化4】

٤

IR1

IR2

IR3

IR4

[0034]

\*40\*【化5】

IR5

IR6

IR7

IR8

[0035]

\* \*【化6】

IR9

IR10

$$Cu^{2+c} = \begin{bmatrix} & O & & & \\ & &$$

IR11

IR12

$$\begin{bmatrix} C_2H_5 & NH_2 \\ C_2H_8 & NH \end{bmatrix}_3$$

[0036]

\* \*【化7】

**IR13** 

$$(t)C^{2}H^{11} = \frac{1}{t}C^{2}H^{11}(t)$$

[0037]

\* \*【化8】

IR15

**FR16** 

IR17

[0038]

IR19
$$C_2H_3-N_2-CH=CH-CH=CH-CH=N-C_2H_6$$

IR21
$$\begin{bmatrix}
S \\
C_2H_8
\end{bmatrix}
C_2H_8$$
CH=CH-)-CH=S
$$C_2H_8$$
C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>

$$C_2H_8$$
Br

IFI22
$$\begin{bmatrix}
S \\
C_{2}H_{8}
\end{bmatrix}$$

$$C_{2}H_{8}$$

$$C_{2}H_{8}$$

$$C_{3}H_{8}$$

$$C_{4}H_{8}$$

IR23
$$\begin{bmatrix}
S_{0} & & & \\
& \downarrow & CH=CH \\
& \downarrow & C_{2}H_{5}
\end{bmatrix}$$
1-

!R28

IR29

IR30

IR31

[0041]

\* \*【化12】

IR32

IR33

IR34

IR35

[0042]

\* \*【化13】

IR37 :

IR38

[0043]

\*【化14】

3 (

29 IR39

IR40

IR41

[0044]

\* \*【化15】

IR42

**IR43** 

IR44

IR45

[0045]

\* \*【化16】

**IR46** 

**IR47** 

**IR48** 

**IR49** 

IR50

R50

$$CH_3$$
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

[0046]

\*40\*【化17】

IR52

**IR54** 

(CH<sub>2</sub>)<sub>e</sub>SO<sub>3</sub>Ne

【0047】これらの色素は公知の方法によって合成す できる。

【0048】日本化薬: 1R750 (アントラキノン 系); I R O O 2 , I R O O 3(アルミニウム系); I R820 (ポリメチン系); IRG022, IRG03 3 (ジインモニウム系); CY-2, CY-4, CY-9, CY-20、三井東圧: KIR103, SIR10 3 (フタロシアニン系); KIR101, SIR114 (アントラキノン系); PA1001, PA1005, PA1006, SIR128 (金属錯体系)、大日本イ ンキ化学: Fastogen blue 8120、みど\*50 る。

\*り化学: MIR-101, 1011, 1021等。その ることができるが、下記のように市販品を用いることも 40 他、日本感光色素、住友化学、富士写真フィルム等の各 社からも市販されている。

> 【0049】本発明において、赤外線吸収剤の添加量 は、0.01~10重量%の範囲が好ましい。該添加量 が10重量%を越えると非画像部 (露光部) の現像性が 低下し、0.01重量%未満では画像部の耐現像性が低 下する。

> 【0050】本発明の酸発生剤ないし光酸発生剤とは、 好ましくはトリアジン系化合物である。添加量は0.0 1~20重量%で、好ましくは0.1~10重量%であ

38 \*た、特開昭50-36209号に記載されているo-ナ

【0051】以下に詳述する。本発明に用いられる活性 光線の照射により酸を発生し得る化合物(以下「光酸発生剤」という)としては、各種の公知化合物及び混合物 が挙げられる。例えばジアゾニウム、ホスホニウム、スルホニウム、及びヨードニウムのBF4 - 、PF6 - 、SbF6 - 、SiF62 - 、C1O4 - などの塩、有機 ハロゲン化合物、オルトキノンージアジドスルホニルクロリド、及び有機金属/有機ハロゲン化合物も活性光線の照射の際に酸を形成又は分離する活性光線感光性成分であり、本発明における光酸発生剤として使用すること 10ができる。原理的には遊離基形成性の光開始剤として知られるすべての有機ハロゲン化合物はハロゲン化水素酸を形成する化合物であり、本発明における光酸発生剤として使用することができる。

【0052】前記のハロゲン化水素酸を形成する化合物の例としては米国特許第3,515,552号、同第3,536,489号及び同第3,779,778号及び西ドイツ国特許公開公報第2,243,621号に記載されているものが挙げられ、また例えば西ドイツ国特許公開公報第2,610,842号に記載の光分解によ 20り酸を発生させる化合物もしようすることができる。ま\*

A

フトキノンジアジドー4ースルホン酸ハロゲニドを用いることができる。 【0053】本発明において、有機ハロゲン化合物が赤 外線露光による画像形成での感度、及び画像形成材料と

外線露光による画像形成での感度、及び画像形成材料として用いた際の保存性等の面から光酸発生剤が好ましい。該有機ハロゲン化合物としては、ハロゲン置換アルキル基を有するオキサジアゾール類が好ましく、ハロゲン置換アルキル基を有するオキサジアゾール類が好ましく、ハロゲン置換アルキル基を有するオキサジアゾール類の具体例としては、特開昭54-74728号、特開昭55-24113号、特開昭55-77742号、特開昭60-3626号及び特開昭60-138539号に記載の2-ハロメチル-1,3,4-オキサジアゾール系化合物が挙げられる。2-ハロメチル-1,3,4-オキサジアゾール系光酸発生剤の好ましい化合物例を下記に挙げる。

【0054】 【化18】

CH = CH  $CCl_s$ 

B CH = CH<sub>3</sub> N CCI<sub>4</sub>

C  $CH_{\bullet}O$  CH = CH  $CCl_{\bullet}O$ 

【0055】上記ハロゲン置換アルキル基を有するsートリアジン類としては、下記一般式(K)で表される化合物が好ましい。

[0056]

【化19】

一般式 (K)

X,C N CX,

※【0057】一般式(K)において、Rはアルキル基、ハロゲン置換アルキル基、アルコキシ基で置換されている
 40 てもよいフェニルビニレン基又はアリール基(例えばフェニル基、ナフチル基等)若しくはその置換体を表し、X3はハロゲン原子を表す。一般式(K)で表されるsートリアジン系光酸発生剤の化合物例を次に示す。

【0058】 【化20】

(2) 
$$CH_sO$$
  $CCI_s$   $CCI_s$   $CCI_s$ 

$$CH_{sO} \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCCI_{s}$$

$$CH_{s}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCl_{s}$$

$$OCH_{s} \longrightarrow CCl_{s}$$

(5) 
$$\begin{array}{c} \text{CCl}_s \\ \text{OCH}_s \end{array}$$

(6) 
$$C_{\bullet}H_{\bullet}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCl_{\bullet}$$

(7) 
$$C_{6}H_{11}O - CH = CH - V$$

$$CCl_{8}$$

$$CCl_{8}$$

【0059】 【化21】

(11) 
$$CI \longrightarrow N \longrightarrow CCCI_s$$

【0060】本発明において光酸発生剤の含有量は、その化学的性質及び感光性組成等或いはその物性によって広範囲に変えることができるが、感光性組成物の乾燥状態又は画像形成材料とした際の感光層の固形分の全重量に対して約0.01~約20重量%の範囲が適当であり、好ましくは0.1~10重量%の範囲である。

【0061】本発明の酸により分解し得る結合を有する 化合物ないし酸分解化合物とは、好ましくは、アセター ル、ケタール基を少なくとも一つ以上有する化合物であ る。添加量は1~80重量%で、好ましくは5~60重 量%である。

【0062】以下詳述する。本発明に用いられる酸によ 50 nが3又は4の化合物が特に好ましい。上記一(CH2

42

り分解し得る結合部を有する化合物(以下「酸分解化合 物」という)としては、具体的には、特開昭48-89 003号、同51-120714号、同53-1334 29号、同55-12995号、同55-126236 号、同56-17345号に記載されているC-O-C 結合を有する化合物、特開昭60-37549号、同6 0-121446号に記載されているSi-O-C結合 を有する化合物、特開昭60-3625号、同60-1 0247号各公報に記載されているその他の酸分解化合 10 物が挙げられ、更に特願昭61-16687号に記載さ れているSi-N結合を有する化合物、特願昭61-9 4603号に記載されている炭酸エステル、特願昭60 -251744号に記載されているオルト炭酸エステ ル、特願昭61-125473号に記載されているオル トチタン酸エステル、特願昭61-125474号に記 載されているオルトケイ酸エステル、特願昭61-15 5481号に記載されているアセタール及びケタール、 特願昭61-87769号に記載されているC-S結合 を有する化合物などが挙げられる。

0 【0063】上記のうち前記特開昭53-133429号、同56-17345号、同60-121446号、同60-37549号及び特願昭60-251744号、同61-155481号に記載されているC-O-C結合を有する化合物、Si-O-C結合を有する化合物、オルト炭酸エステル、アセタール類、ケタール類及びシリルエーテル類が好ましい。それらの中でも特開昭53-133429号に記載された主鎖中に繰り返しアセタール又はケタール部分を有し、現像液中でのその溶解度が酸の作用によって上昇する有機重合化合物及び特

30 開昭63-10153号に記載の下記構造単位

[0064]

(ここで、Xは ——C ← 又は ——H を表し、 Yは ——C ← を表す。更にX及びYはそれぞれ 同一でも異なっていてもよい。)

【0065】を有し、酸により分解し得る化合物が特に 好ましい。

【0066】本発明に用いられる酸分解化合物の具体例 としては前記各公知例に記載された化合物を挙げること ができる。又、該化合物の合成方法も前記各公知例に記 載されている。

【0067】本発明において、酸分解化合物として、一(CH2CH2O)n一基(nは2~5の整数を表す)を有する化合物が感度及び現像性のバランスの点から好ましい。又、該化合物のうちエチレンオキシ基の連鎖数nが3又は4の化合物が特に好ましい。上記一(CH2

CH2 O) n -基を有する化合物の具体例としてはジメ トキシシクロヘキサン、ベンズアルデヒド及びそれらの 置換誘導体と、ジエチレングリコール、トリエチレング リコール、テトラエチレングリコール及びペンタエチレ ングリコールの何れかとの縮合生成物が挙げられる。 \* **一般式(L)** 

\*【0068】又、本発明において、酸分解化合物とし て、下記一般式(L)で表される化合物が感度及び現像 性の点から好ましい。

44

[0069]

【化23】

$$(R)_{\bullet} = (0 - CH_{z} - CH_{z})_{m} - O - (CH_{x} - CH_{z} - O)_{n} - (CH_{x} - CH_{x} - O)_{n} - (CH_{x} - O)_{n} - (CH$$

【0070】式中、R、R1及びR2は各々水素原子、 炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数1~5のア ルコキシ基、スルホ基、カルボキシル基又はヒドロキシ ル基を表し、p、q及びrは各々1~3の整数を表し、 m及びnは各々1~5の整数を表す。R、R<sub>1</sub> 及びR<sub>2</sub> が表すアルキル基は直鎖でも分岐でもよく、例えばメチ ル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル 基、tertーブチル基、ペンチル基等が挙げられ、ア 20 ルコキシ基としては例えばメトキシ基、エトキシ基、プ ロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、tert ープトキシ基、ペントキシ基等が挙げられ、スルホ基及 びカルボキシル基はその塩を包含する。一般式 (L)で 表される化合物のうち、m及びnが1又は2である化合 物が特に好ましい。一般式(L)で表される化合物は公 知の方法で合成することができる。

【0071】本発明において、酸分解化合物の含有量 は、感光性組成物或いは画像形成材料として用いた際の 量%が好ましく、特に好ましくは5~60重量%であ る。酸分解化合物は1種を用いてもよいし、2種以上を 混合して用いてもよい。

【0072】本発明の酸により架橋し得る基を有する化 合物ないし架橋剤とは、以下に示すものであり、添加量 は1~80重量%で、好ましくは5~60重量%であ る.

【0073】本発明において、酸により架橋する基を有 する化合物としては、酸の存在下でアルカリ可溶性樹脂 と架橋し得る化合物(以下、架橋剤という)、即ち架橋 40 しアルカリに対する溶解性を低減させ得る架橋剤であ る。アルカリに対する溶解性を低減させ得る程度として は、アルカリ可溶性樹脂と架橋することによって該樹脂 が全くアルカリ不溶性を示す物性に変化すればよく、具 体的には、画像形成材料として用いた際、露光により前 記架橋剤の作用で本来アルカリ可溶性であったものが現 像剤として用いるアルカリ溶液に対して不溶性を示し、 支持体上に残存している状態を表す。前記架橋剤として は、メチロール基又はメチロール基の誘導体、メラミン 樹脂、フラン樹脂、イソシアネート、ブロックドーイソ※50 量体である。

※シアネート (保護基を有すイソシアネート) 等が挙げら れるが、メチロール基又はアセチル化メチロール基を有 している架橋剤が望ましい。感光性組成物に対する添加 量は1~80重量%、好ましくは5~60重量%であ る。

【0074】バインダーについては、他の樹脂を併用し てもよい。例えばアクリルバインダー、ノボラック樹脂 等の単独あるいは併用も可能である。以下、この点につ いて詳述する。

【0075】バインダー樹脂としては、ポリエステル系 樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリウレタン系樹 脂、ポリアミド系樹脂、セルロース系樹脂、オレフィン 系樹脂、塩化ビニル系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、 スチレン系樹脂、ポリカーボネート、ポリビニルアルコ ール、ポリビニルピロリドン、ポリサルフォン、ポリカ プロラクトン樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、尿素樹 脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、ゴム系樹脂等が挙 感光層を形成する組成物の全固形分に対し、1~80重 30 げられる。又、樹脂内に不飽和結合を有する樹脂、例え ばジアリルフタレート樹脂及びその誘導体、塩素化ポリ プロピレン等は前述のエチレン性不飽和結合を有する化 合物と重合させることが可能なため用途に応じて好適に 用いることができる。バインダー樹脂としては前述の樹 脂の中から、1種又は2種以上のものを組み合わせて用 いることができる。

> 【0076】本発明で用いることが可能なバインダーと しては、本発明に含有させる有機溶剤に可溶の親油性の 高分子は、バインダーとして機能するものであればその 種類は任意であるが、酸価が20~250の親油性高分 子化合物が好ましい。

【0077】これら、高分子重量体としては、例えば、 ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリス チレン、ポリウレタン、ポリピニルクロライド、及びそ のコポリマー、ボリビニルブチラール樹脂、ポリビニル ホルマール樹脂、シェラック、エポキシ樹脂、フェノー ル樹脂、アクリル樹脂等が挙げられる。これらの中で好 ましい高分子重合体は、下記(1)~(17)に記載の モノマーの混合物を共重合して得られた共重合高分子重

【0078】上記モノマー混合物には、上記モノマーと 共重合し得る他のモノマーを混合してもよい。又、高分 子重合体は、上記モノマーの共重合体によって得られる 共重合体を例えば、グリシジルアクリレート、グリシジ ルメタクリレート等によって修飾したものであってもよ 11

(1) 芳香族水酸基を有するモノマー、例えば、oーヒ ドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレン

mーヒドロキシスチレン、oーヒドロキシフェニルアク ヒドロキシフェニルアクリレート等。

- (2) 脂肪族水酸基を有するモノマー、例えば、2-ヒ ドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、Nーメチロールアクリルアミド、Nーメ チロールメタクリルアミド、4-ヒドロキシブチルメタ クリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、5 ーヒドロキシペンチルメタクリレート、6ーヒドロキシ ヘキシルアクリレート、6-ヒドロキシヘキシルメタク リレート、N-(2-ヒドロキシエチル)アクリルアミ ド、N-(2-ヒドロキシエチル)メタクリルアミド、 ヒドロキシエチルビニルエーテル等。
- (3) アミノスルホニル基を有するモノマー、例えば、 m-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、p-ア ミノスルホニルフェニルメタクリレート、mーアミノス ルホニルフェニルアクリレート、p-アミノフェニルア クリレート、N- (p-アミノスルホニルフェニル)メ タクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニ ル) アクリルアミド等。
- (4) スルホンアミド基を有するモノマー、例えば、N - (p-トルエンスルホニル) アクリルアミド、N-(p-トルエンスルホンル) メタクリルアミド等。
- (5) α, β-不飽和カルボン酸類、例えば、アクリル 酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタ コン酸、無水イタコン酸等。
- (6) 置換又は無置換のアルキルアクリレート、例え ば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸 プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アク リル酸ヘキシル、アクリル酸ヘプチル、アクリル酸オク チル、アクリル酸ノニル、アクリル酸デシル、アクリル 酸ウンデシル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸ベンジ 40 レン、p-シアノスチレン等。 ル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸-2-クロ ロエチル、N, Nージメチルアミノエチルアクリレー ト、グリシジルアクリレート等。
- (7) 置換又は無置換のアルキルメタクリレート、例え ば、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタク リル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ア ミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸ヘプチル、 メタクリル酸オクチル、メタクリル酸ノニル、メタクリ ル酸デシル、メタクリル酸ウンデシル、メタクリル酸ド

キシル、メタクリル酸-2-クロロエチル、N,N-ジ メチルアミノエチルメタクリレート、グリシジルメタク リレート等。

46

(8) アクリルアミド若しくはメタクリルアミド類、例 えば、アクリルアミド、メタクリルアミド、N-エチル アクリルアミド、Nーヘキシルアクリルアミド、Nーシ クロヘキシルアクリルアミド、N-フェニルアクリルア ミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-エチル -N-フェニルアクリルアミド、N-(4-ヒドロキシ リレート、pーヒドロキシフェニルアクリレート、m- 10 フェニル) アクリルアミド、N- (4ーヒドロキシフェ ニル) メタクリルアミド等。

- (9)フッ化アルキル基を含有するモノマー、例えば、 トリフルオロエチルアクリレート、トリフルオロエチル メタクリレート、テトラフルオロプロピルメタクリレー ト、ヘキサフルオロプロピルメタクリレート、オクタフ ルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチル メタクリレート、ヘプタデカフルオロデシルメタクリレ ート、NーブチルーNー (2-アクリロキシエチル)へ プタデカフルオロオクチルスルホンアミド等。
- 20 (10) ビニルエーテル類、例えば、エチルビニルエー テル、2-クロロエチルビニルエーテル、プロピルビニ ルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエ ーテル、フェニルビニルエーテル等。
  - (11) ビニルエステル類、例えば、ビニルアセテー ト、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息 香酸ビニル等。
  - (12) スチレン類、例えば、スチレン、メチルスチレ ン、クロロメチルスチレン等。
- (13) ビニルケトン類、例えば、メチルビニルケト 30 ン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェ ニルビニルケトン等。
  - (14) オレフィン類、例えば、エチレン、プロピレ ン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等。
  - (15) Nービニルピロリドン、Nービニルカルバゾー ル、4ービニルピリジン等。
  - (16) シアノ基を有するモノマー、例えば、アクリロ ニトリル、メタクリロニトリル、2-ペンテンニトリ ル、2ーメチルー3ーブテンニトリル、2ーシアノエチ ルアクリレート、oーシアノスチレン、mーシアノスチ
  - (17) アミノ基を有するモノマー、例えば、N, N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、N、Nージメチ ルアミノエチルアクリレート、N,N-ジメチルアミノ エチルメタクリレート、ポリブタジエン、ウレタンアク リレート、N、Nージメチルアミノプロピルアクリルア ミド、N, N-ジメチルアクリルアミド、アクリロイル モルホリン、N-イソプロピルアクリルアミド、N,N ージエチルアクリルアミド等。

【0079】上記、共重合体は、ゲルパーミエーション デシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸シクロへ 50 クロマトグラフィー (GPC)によって、測定された重 量平均分子量が1万~20万であるものが好ましいが、重量平均分子量はこの範囲に限定されるものではない。 【0080】上記高分子重合体には、必要に応じて、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、エボキシ樹脂、ノボラック樹脂、天然樹脂等、他の任意の高分子重合体を併用してもよい。感光性組成物中におけるこれらの高分子重合体の含有量は、20~90重量%の範囲が好ましく、30~70重量%の範囲が更に好ましい。

【0081】本発明において、上記高分子化合物のうち 10 アクリル系重合体が好ましい。

【0082】本発明の他の素材については、従来から知られたものを特別の制限なく使用できる。

【0083】(界面活性剤)本発明においては、フッ素系界面活性剤を0.001~5重量%含有させることが経時による非画像部の汚れ発生防止の点から好ましい。フッ素系界面活性剤としては例えば次のような化合物が挙げられる。

[0084]

C7 F15 CO2 NH4,

C<sub>8</sub> F<sub>1</sub> 7 SO<sub>2</sub> N (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>) CH<sub>2</sub> COOK,

 $C_8 F_{1.7} SO_2 NHC_3 H_6 N^+ (CH_3)_2 C_{1-}$ 

 $C_7 F_{1.5} CONH (CH_2)_3 N^+ (CH_3)_2 C_2$  $H_4 COO^-$ ,

C<sub>8</sub> F<sub>1</sub> 7 SO<sub>2</sub> N (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>) C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> (OC 3 H<sub>6</sub>) 5 OH,

 $C_7 F_{15} CONHC_3 H_6 N^+ (CH_3)_2 (CH_2)_2 COO^-$ 

[0085]

【化24】

$$C_8F_{17}SO_2NHCH_2$$
—SO<sub>3</sub>Na ,

$$CH_2COO^-$$
  
 $\uparrow$   
 $C_6F_{19}SO_2 - NC_9H_6N^+$  (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,

$$C_8F_{17}SO_2N-(CH_2)_8N^+$$
 (CH\_9)  $_2CH_2COO^-$  ,  $C_9H_7$ 

[0086] C<sub>8</sub> F<sub>1</sub> 7 SO<sub>2</sub> NHC<sub>3</sub> H<sub>6</sub> N<sup>+</sup> (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OS<sup>-</sup> O<sub>2</sub> OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>,

 $C_7 F_{15} CONHC_3 H_6 N^+ (CH_3)_3 Cl^-,$  [0087]

10007

【化25】

$$C_8F_{17}SO_2NHC_3H_6 - N^+ OO^-SO_2C_2H_5$$
 ,

$$C_2H_5$$
  
|  $C_3F_{17}SO_2 - NCH_2CH_2O$  ( $CH_2CH_2O$ )  $_{10}H$  ,

[0088]  $C_8$   $F_{1.7}$   $SO_2$  N (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>  $CH_2$   $O_2$  OCH=CH<sub>2</sub>,

[0089]

【化26】

【0090】フッ素系界面活性剤としては市販品を用いることもでき、例えばサーフロン「S-381」、「S-382」、「SC-101」、「SC-102」、
20 「SC-103」、「SC-104」(何れも旭硝子 (株)製)、フロラード「FC-430」、「FC-431」、「FC-431」、「FC-173」(何れもフロロケミカルー住友スリーエム製)、エフトップ「EF352」、「EF301」、「EF303」(何れも新秋田化成(株)製)、シュベゴーフルアー「8035」、「8036」(何れもシュベグマン社製)、「BM1000」、「BM1100」(何れもビーエム・ヒミー社製)、メガファック「F-171」、「F-177」、「F-179」(何れも大日本インキ化学(株)製)、などを挙げることができる。

【0091】本発明におけるフッ素系界面活性剤のフッ素含有割合は、0.05~2%、好ましくは0.1~1%である。上記のフッ素系界面活性剤は、1種又は2種以上を併用することができ、又その他の界面活性剤とを併用することができる。

【0092】更に、本発明の感光性組成物には、感脂性を向上するために親油性の樹脂を添加することができる。上記親油性の樹脂としては、例えば、特開昭50-125806号に記載されているような、炭素数3~15のアルキル基で置換されたフェノール類とアルデヒドの縮合物、例えばtーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂等が使用可能である。

【0093】(塗布溶剤)本発明の感光性組成物に、用いる溶剤について説明する。

【0094】例えばnープロパノール、イソプロピルアルコール、nーブタノール、secーブタノール、イソブタノール、3ーメチルー1ーブタノール、3ーメチルー1ーブタノール、2ーメチルー2ーブタノール、2ーペンチルー1ーブタノール、1ーペンタノール、2ーペンタノール、3ーペンタノール、nーへキサノール、2ー

ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキ サノール、1-ヘプタノール、2-ヘプタノール、3-ヘプタノール、1ーオクタノール、4ーメチルー2ーペ ンタノール、2-ヘキシルアルコール、ベンジルアルコ ール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ト リエチレングリコール、テトラエチレングリコール、 1,3-プロパンジオール、1,5-ペンタングリコー ル、ジメチルトリグリコール、フリフリルアルコール、 ヘキシレングリコール、ヘキシルエーテル、3ーメトキ シー1ーブタノール、3ーメトキシー3ーメチルブタノ 10 ロヘプタン、nーオクタン、イソオクタン、ノナン、デ ール、ブチルフェニルエーテル、エチレングリコールモ ノアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピ レングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリ コールモノブチルエーテル、プロピレングリコールフェ ニルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエー テル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ プロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピ レングリコールモノブチルエーテル、トリプロピレング リコールモノメチルエーテル、メチルカルビトール、エ 20 チルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、ブ チルカルビトール、トリエチレングリコールモノメチル エーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテ ル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、ジア セトンアルコール、アセトフェノン、シクロヘキサノ ン、メチルシクロヘキサノン、アセトニルアセトン、イ ソホロン、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、炭酸 プロピレン、酢酸フェニル、酢酸-sec-ブチル、酢 酸シクロヘキシル、シュウ酸ジエチル、安息香酸メチ ル、安息香酸エチル、アーブチルラクトン、3ーメトキ 30 シー1ーブタノール、4ーメトキシー1ーブタノール、 3-エトキシー1-ブタノール、3-メトキシー3-メ チルー1ーブタノール、3ーメトキシー3ーエチルー1 ーペンタノール、4-エトキシー1-ペンタノール、5 ーメトキシー1-ヘキサノール、3-ヒドロキシー2-ブタノン、4ーヒドロキシー2ーブタノン、4ーヒドロ キシー2ーペンタノン、5ーヒドロキシー2ーペンタノ ン、4-ヒドロキシー3-ペンタノン、6-ヒドロキシ -2-ペンタノン、4-ヒドロキシ-3-ペンタノン、 6-ヒロドキシー2-ヘキサノン、3-メチルー3-ヒ 40 鋼、銅等の金属板、並びにクロム、亜鉛、銅、ニッケ ドロキシー2-ペンタノン、メチルセルソルブ (M C) エチルセルソルブ (EC) 等が挙げられる。 【0095】アリルアルコール、イソプロピルエーテ

ル、ブチルエーテル、アニソール、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、ジエチルカルビトー ル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジオキソラン、 アセトン、メチルプロピルケトン、メチルエチルケト ン、メチルアミルケトン、ジエチルケトン、エチルブチ ルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、3

タノン、酢酸-2-メトキシエチル、酢酸-2-エトキ シエチル、酢酸メトキシブチル、プロピオン酸メチル、 プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロピル、酪酸メチ ル、酪酸エチル、酪酸ブチル、Nーメチルー2ーピロリ ドン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド (DM F)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、nーペンタ ン、2ーメチルペンタン、3ーエチルペンタン、メチル シクロペンタン、nーヘキサン、イソヘキサン、シクロ ヘキサン、メチルシクロヘキサン、n-ヘプタン、シク カン、ベンゼン、トルエン、oーキシレン、mーキシレ ン、pーキシレン、エチルベンゼン、oージエチルベン ゼン、mージエチルベンゼン、pージエチルベンゼン、 クメン、n-アミルベンゼン、ジメチルジグリコール (DMDG)、エタノール等が挙げられる。

【0096】本発明の画像形成材料には700 nm以上 の光源を用い画像評価を行う。光源としては、半導体レ ーザー、He-Neレーザー、YAGレーザー、炭酸ガ スレーザー等が挙げられるがこれに限るものではない。 出力は50mW以上が適当であり、好ましくは100m W以上である。

【0097】(現像液及び現像条件)アルカリ剤中に含 まれる金属塩の濃度は0.05~20重量%の範囲で、 より好ましくは0.1~10重量%である。特開昭57 -7427号、特公昭57-7427号等記載のものも 可能である。

【0098】本発明の感光性組成物には必要に応じて、 更に上記以外の色素、顔料、増感剤、可視画剤等を含有 させることができる。

#### 【0099】<2>画像形成材料

本発明の画像形成材料は、支持体上に、上記の感光性組 成物を含有する感光層を有してなることを特徴とする。 具体的には、上記の感光性組成物(本発明の条件を満足 する溶剤を含有)の塗布液を適当な支持体の表面に塗布 して感性層を設け、乾燥することで得られる。

【0100】本発明においては、上記感光層の残留溶剤 量が5mg/m2 以下であることが好ましく、 更に好ま しくは3mg/m<sup>2</sup>以下である。

【0101】支持体としては、アルミニウム、亜鉛、 ル、アルミニウム、鉄等がメッキ又は蒸着された金属

板、紙、プラスチックフィルム及びガラス板、樹脂が塗 布された紙、アルミニウム等の金属箔が張られた紙、親 水化処理したプラスチックフィルム等が挙げられる。

【0102】本発明を感光性平阪印刷版に適用する際、 支持体として砂目立て処理、陽極酸化処理及び必要に応 じて封孔処理等の表面処理等が施されているアルミニウ ム板を用いることが好ましい。これらの処理は公知の方 法を適用できる。

ーヒドロキシー2-ブタノン、4-ヒドロキシー2-ブ 50 【0103】砂目立て処理の方法としては、例えば機械

的方法、電解によりエッチングする方法が挙げられる。 機械的方法としては、例えばボール研磨法、ブラシ研磨 法、液体ホーニングによる研磨法、バフ研磨法等が挙げ られる。アルミニウム材の組成等に応じて上述の各種方 法を単独或いは組み合わせ用いることができる。又電解 によりエッチングするには、リン酸、硫酸、塩酸、硝酸 等の無機の酸を単独乃至2種以上混合した浴を用いて行 われる。砂目立て処理の後、必要に応じてアルカリ或い は酸の水溶液によってデスマット処理を行い中和して水 洗する。

【0104】陽極酸化処理は、電解液として、硫酸、ク ロム酸、シュウ酸、リン酸、マロン酸等を1種又は2種 以上含む溶液を用い、アルミニウム板を陽極として電解 して行われる。形成された陽極酸化被膜量は1~50m g/dm<sup>2</sup>が適当であり、好ましくは10~40mg/ dm<sup>2</sup>であり、特に好ましくは25~40mg/dm<sup>2</sup> である。陽極酸化被膜量は、例えばアルミニウム板をリ ン酸クロム酸溶液(リン酸85%液:35m1、酸化ク ロム (IV): 20gを1リットルの水に溶解して作 製)に浸漬し、酸化被膜を溶解し、板の被膜溶解前後の 20 重量変化測定から求められる。

【0105】封孔処理は、沸騰水処理、水蒸気処理、ケ イ酸ソーダ処理、重クロム酸塩水溶液処理等が具体例と して挙げられる。この他にアルミニウム板支持体に対し て、水溶性高分子化合物や、フッ化ジルコン酸等の金属 塩の水溶液による下引き処理を施すこともできる。

【0106】<3>画像形成材料の製造方法 本発明の画像形成材料の製造方法は、アルミニウム支持 体上に上記感光性組成物を設けた後、乾燥温度85℃以 上、乾燥時間10秒以上の条件で処理することを特徴と 30 する。好ましくは乾燥温度90℃以上、乾燥時間30秒 以上であり、それらの条件で感光層表面の残留溶剤量が 5mg/m2以下となるよう処理することが好ましい。 【0107】塗布方法は従来公知の方法、例えば回転塗

布、ワイヤーバー塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗 布、ロール塗布、ブレード塗布及びカーテン塗布等が可 能である。塗布量は用途により異なるが、例えば、感光 性平版印刷版についていえば固形分として0.5~5. Og/m² が好ましい。

【0108】本発明の画像形成材料には波長700nm 40 以上の光源を用い画像露光を行うのが好ましい。光源と しては、半導体レーザー、He-Neレーザー、YAG レーザー、炭酸ガスレーザー等が挙げられる。出力は5 OmW以上が適当であり、好ましくは100mW以上で ある。

【0109】本発明の画像形成材料の現像に用いられる 現像液としては、水系アルカリ現像液が好適であり、水 系アルカリ現像液としては、例えば、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、 メタケイ酸ナトリウム、メタケイ酸カリウム、第二リン 50 対して不溶化し得る化合物、赤外吸収剤及び感光層の乾

52

酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウム等のアルカリ金属 塩の水溶液が挙げられる。アルカリ金属塩の温度は0. 05~20重量%の範囲で用いるのが好適であり、より 好ましくは、0.1~10重量%である。

【0110】本発明の画像形成方法において、現像液に は、必要に応じてアニオン性界面活性剤、両性界面活性 剤やアルコール等の有機溶剤を加えることができる。

【0111】有機溶剤としては、プロピレングリコー ル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、ベンジ 10 ルアルコール、n-プロピレンアルコール等が有用であ

【0112】(本発明の可視画性染料) R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R 3のアルキル基とは、C1~C5の範囲のアルキル基を 示し、好ましくはC1~C3である。又、水素原子でも かまわない。アルコキシ基とは、メトキシ基、エトキシ 基、ブトキシ基が好ましい。アルキルヒドロキシ基とは ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基が好ましい。 アルキルオキシ基とは、メトキシメチル基、メトキシエ チル基、エトキシメチル基、エトキシエチル基等が好ま LW

【0113】Xは、ハロゲン原子としては、塩素、臭 素、ヨードが好ましく、アニオン分子ならスルホン酸、 1/2ZnCl2等がよく特に制限はない。

【0114】添加量は全体の固形分に対して、0.1~ 10重量%が好ましく、より好ましくは0.5~5重量

【0115】染料吸収のピークは、可視画性として人が みやすい波長が好ましい。又、本感材においては、感材 が赤外レーザーで露光するためこの波長により吸収を得 ない波長なら制限はない。特に本感材で使用する可視画 材染料としては、400~700 nmの波長が好まし 11

【0116】 (塩基性化合物) 塩基性化合物はプロトン を補足可能なものであれば上記に示した化合物以外に特 に制限なく使用できる。

【0117】これらの塩基性化合物は単独又は2種以上 組み合わせて用いても良い。使用量は感光層中に0.0 01~10重量%が好ましく、0.01~5重量%がよ り好ましい。0.001重量%以下では保存安定性向 上、露光後の経時小点再現性低下抑制の効果がなく、又

10重量%以上では感度低下等が著しい。

【0118】尚、本タイプの平版印刷版の感光層には、 以下に詳述するマット剤を添加することも可能であり、 その形態も感光層に含有せしめるか、又は感光層表面に 固着せしめるという2つが挙げられる。

【0119】マット剤含有タイプ

本タイプの平版印刷版材料は、a) 支持体上に、活性光 線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し 得る結合部を有する化合物又は酸の存在下でアルカリに 燥膜厚以上の粒径を有するマット剤を含有するもの、或 いはb)支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し 得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物 及び赤外吸収剤を有する感光層を設け、該感光層表面に マット剤を有する、具体的には層表面に固着されてなる ものである。

【0120】(紫外線吸収剤)本発明に用いる紫外線吸 収剤としては、公知の種々のものを用いることができ、 例えばサルチル酸系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリア れらの具体的な若干例を以下に示す。

【0121】pーtertーブチルフェニルサリシレー

p-オクチルフェニルサリシレート フェニルサリシレート

2.4-ヒドロキシベンゾフェノン

2-ヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン

2-ヒドロキシー4ーオクトキベンゾフェノン

2-ヒドロキシー4ードデシルオキシベンゾフェノン

2, 2′-ジヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン 20 2, 2'ージヒドロキシー4, 4'ージメトキシベンゾ フェノン

2-ヒドロキシー4-メトキシー5-スルホベンゾフェ ノン

2-(2'-ヒドロキシ-5'-メトキシフェニル)ベ ンゾトリアゾール

2-(2'-ヒドロキシ-5'-tert-ブチルフェ ニル) ベンゾトリアゾール

2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル) ベンゾトリアゾール

2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-

5′ーメチルフェニル)ー5ーベンゾトリアゾール

2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール

2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-アミルフェニル) ベンゾトリアゾール

2-(2'-1)+2-3', 5'-1+2ージメチルベンジルフェニル) -5-クロロベンゾトリ アゾール

ェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート 系のものである。これらの紫外線吸収剤は単独で使用し てもよいし、2種以上を混合して使用してもよい。

【0122】本発明に用いられる紫外線吸収剤の添加量 は、使用するレーザー光源(吸収波長、強度)を考慮し て選択される。

【0123】(マット剤)マット剤(微粉末又は微粒 子) の好ましい具体例としては、ポリ酢酸ビニル、ポリ ビニリデンクロリド、ポリエチレンオキシド、ポリエチ レングリコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミ

54

ド、ポリアクリル酸アルキルエステル、ポリスチレン及 びポリスチレン誘導体並びにこれらの重合体を形成する 単量体を用いた共重合体、ポリビニルメチルエーテル、 エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド、ポリビニ ルブチラール、二酸化ケイ素、珪藻土、酸化亜鉛、酸化 チタン、酸化ジルコニウム、ガラス、アルミナ、デキス トリン、澱粉、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸 亜鉛、多糖脂肪酸エステル、合成高分子等を挙げること ができる。これらマット剤は現像液に可溶であることが ゾール系、シアノアクリレート系等が挙げられるが、こ 10 好ましく、現像液により適宜選択するのが望ましい。例 えば、現像液として強アルカリ性水溶液を使用する場合 は、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピル セルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリニトリ ルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル 酸、ポリアクリル酸アルキルエステル、ポリスチレン誘 導体、及びフェノール樹脂等が好ましく適用される。他 の現像液として、アルコール類、グリコール類、ケトン 類等の有機溶媒を用いた場合には、セルロース誘導体、 ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ酢 酸ビニル、ポリビニリデンクロリド、ポリアクリル酸、 ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸アルキルエステ ル、ポリスチレン、アクリル酸アルキルエステル、アク リルアミド、スチレンを単量体の1つとする共重合体、 エポキシ樹脂、フェノール樹脂等が好ましく適用され る。

> 【0124】感光層表面に固着される融成物を形成する ための融解性高分子からなるマット剤を、感光層表面に パウダリング(振りかける、或いは分散、散布)し、加 熱処理することにより該マット剤が融解現象を起こし、 30 温度の降下に伴い固形化し球状帽子型の融成物を形成す る。

【0125】これらマット剤として好ましいものは、ポ リ酢酸ビニル、ポリビニリデンクロリド、ポリエチレン オキシド、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸、 ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸アルキルエステ ル、ポリスチレン及びポリスチレン誘導体並びにこれら の重合体の単量体を用いた共重合体、ポリビニルメチル エーテル、エポキシ樹脂、可融性フェノール樹脂、ポリ アミド、ポリビニルブチラール等を挙げることができ これらの紫外線吸収剤のうち好ましいものは、ベンゾフ 40 る。これらは感光層組成物の現像液に応じて適宜選択す ることが望ましく、例えば現像液に強アルカリ性水溶液 を使用する場合、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロ キシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロー ス、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポ リアクリル酸、ポリアクリルアルキルエステル、ポリス チレン誘導体、及び可融性フェノール樹脂等が好ましく 適用される。又アルコール類、グリコール類、ケトン類 等有機溶媒を用いた場合は、セルロース誘導体、ポリビ ニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニ 50 ル、ポリビニリデンクロリド、ポリアクリル酸アルキル エステル、ポリスチレン、エポキシ樹脂、可融性フェノ ール樹脂及びアクリル酸、アクリルアミド、アクリル酸 アルキルエステル、スチレンを少なくとも単量体の1つ とする共重合体等が好ましく適用される。

【0126】上記マット剤の形状は、球形、不定形、そ の他の特定形状でもよく、又マット剤は、マット剤同士 の凝集防止を目的として表面を改質しても差し支えな い。マット剤の平均粒径は、感光層内に設ける場合(). 1~30μmが好ましく、1~10μmがより好まし い。この際、感光層の乾燥膜厚よりも大きいマット剤の 10 れにより得られる効果も上述したものである。 粒径のものが存在することが必須である。一方、感光層 表面に存在せしめる場合は、 $0.01 \sim 20 \mu m$ が好ま しく、 $0.1\sim10\mu$ mがより好ましい。

【0127】マット剤を形成する方法として、該マット 剤を感光層に含有せしめる場合には、該マット剤を感光 層塗布液に添加し、超音波分散でマット剤を分散した直 後に、得られた感光層塗布液を支持体に塗設する。他 方、感光層の表面にマット剤を存在せしめる場合には、 感光層表面のマット剤付き量を0.005~3g/m<sup>2</sup> とするのが好ましく、0.05~1g/m<sup>2</sup>とするのが 20 より好ましい。

【0128】感光層の表面にマット剤を存在せしめる具 体的な方法としては、例えばマット剤をパウダリングす る、マット剤の分散液を感光層に直接塗布し、乾燥時に 表面に融着させる、マット剤の分散液又は溶液をスプレ ーし(吹き付ける)、乾燥時に表面に融着させる方法等 を挙げることができる。

【0129】パウダリングする方法、即ち感光層表面に マット剤を振りかけるには、マット剤を粉体塗布法、流 動浸漬法、静電粉体吹き付け法、静電流動浸清法等の方 30 法により、予め支持体上に形成しておいた感光層上に均 一に分散或いは散布するのがよい。そしてパウダリング の後、適宜加熱処理 (融着処理)を行うことにより感光 層表面にマット剤を融着させることができる。融着処理 は、熱風又は赤外線ヒーター等の熱源を用いて50~1 30℃に加温された炉内に入れるか、加熱ロールを介し てマット剤を融解させる。このとき一部のマット剤同士 が一体化することもあり、得られる融成物は感光層上に 球状帽子型となって固着分散し、本発明のブロッキング 防止という効果を有効に奏することができる。マット剤 40 同士の接触は融成物の表面及び内部に固着せしめられる が、印刷板には何ら影響を及ぼすことはない。

【0130】マット剤の分散液を感光層に直接塗布し、 乾燥時に表面に融着させる場合には、感光層を溶解しな い有機溶媒又は水、複数種からなる混合溶剤にマット剤 を添加し、超音波分散で該マット剤を分散した直後に感 光層上にマット剤分散液を塗設し乾燥することにより達 成される。

【0131】マット剤の分散液をスプレーし、乾燥時に 表面に融着させる場合には、マット剤の超音波分散液を 50 感光層表面にスプレーし、乾燥して表面に融着させるこ とにより達成される。分散液の分散溶媒としては防爆や 環境適性、作業適性等の点で水が好ましく、又マット剤 分散液のマット剤の含有率は10~30重量%が望まし い。スプレーの方法としては、エアースプレー法、エア ーレススプレー、静電エアースプレー、静電霧化静電塗 布法等の公知の方法が採用可能である。

56

【0132】尚、本タイプの平版印刷版の感光層には、 上述した塩基性化合物を添加することも可能であり、そ

【0133】 [請求項1~3記載のハイオルソノボラッ ク樹脂について] 特定組成のフェノール成分とアルデヒ ド類又はケトン類を共縮合することにより製造され、か つ前記に規定する所定のX値を有するノボラック樹脂を 使用することを要件とし、このいずれか一方が欠けても 本発明の効果が得られない。このような樹脂を製造する 際、フェノール成分は、(1)フェノール類 0~50 モル%、(2) m-アルキルフェノール類 20~80 モル%、(3)p-アルキルフェノール類 20~80 モル%の範囲から選ばれ、上記(1)フェノールと共に (2) m-アルキルフェノール類と(3) p-アルキル フェノール類の少なくとも一種を含むものが好ましい。 m-, p-アルキル基フェノールのアルキル基は低級ア ルキル基であり、メチル、エチル、プロピル、オクチ ル、ノニル、ヘキシル、i-プロピル基等である。

【0134】より好ましくは、(1)フェノール類 0 ~50モル%、(2) mーアルキルフェノール類 20 ~80モル%、(3)p-アルキルフェノール類 20 ~80モル%からなるフェノール成分を用いて製造され た樹脂であり、さらにはフェノール成分が0~40モル %、(2) m-アルキルフェノール類 30~80モル %、(3) p-アルキルフェノール類 20~80モル %からなることが好ましい。

【0135】 [請求項4記載の低分子量ハイオルソノボ ラック→再度共縮合] 上記請求項1~3の詳細記載内容 で合成した低分子量ハイオルソノボラックを再度、フェ ノール成分(上記記載のフェノール化合物)とアルデヒ ド類又はケトン類を縮合させできた樹脂からなるノボラ ック樹脂(2次反応、重合条件は通常条件と同じ)。ノ ボラック樹脂の感光層の含有量は、上記請求項1~3と

【0136】[請求項4記載のハイオルソノボラック樹 脂] ノボラック樹脂の感光層の含有量は、上記請求項1 ~3と同じである。

【0137】[請求項5~7記載の芳香族系アルデヒド 類、芳香族系ケトン類で縮合した樹脂] 芳香族アルデヒ ド(モノアルデヒド、ジアルデヒド、トリアルデヒド等 でもよい) としては、特に好ましくは、ヒドロキシル基 含有芳香族アルデヒドである。

【0138】[請求項8~9記載のナフトールノボラッ

ク樹脂]ノボラック樹脂の感光層の含有量は、上記請求 項1~3と同じである。

【0139】(感材膜面pH)次に膜面pHの定義につ いて述べる。

測定装置: 東亜電波工業社のデジタルp HメーターHM

作成:支持体上に感材感光層を2g/m²設置した印刷

測定: pHメーターを標準化したのち、マイクロピペッ トで純水10μ1を測り取り、測定すべきサンプルに滴 10 ン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミ 下し該水滴に対し垂直にpHメーターの測定部を下ろし 膜面に設置して2分後の測定値を膜面pHとした。

【0140】保存安定性向上、露光後経時小点再現性低 下抑制には膜面p Hが4~8が好ましい。より好ましく は膜面pHが5~7. 4以下では保存安定性向上、露光 後経時小点再現性低下抑制の効果がなく、8以上では感 度低下が著しい。

【0141】次に塗布液pHについて述べる。

測定装置: 東亜電波工業(株)のデジタルp Hメーター HM-30S

調整:塗布に使用する任意の有機溶剤又は水又は複数の 混合溶剤に溶解した感材塗布液を固形分10重量%とし

【0142】測定:pHメーターを標準化したのち、測 定すべき塗布液に対し垂直にpHメーターの測定部を下 ろし途布液に2分浸漬した際の測定値を塗布液pHとし た。

【0143】保存安定性向上、露光後経時小点再現性低 下抑制には塗布液pHが3.5~8が好ましい。より好 ましくは4~6.5。3.5以下では保存安定性向上、 露光後経時小点再現性低下抑制の効果がなく、8以上で は感度低下が著しい。

【0144】次に塩基性化合物について述べる。塩基性 化合物は、プロトン(H+)を捕捉可能な化合物のこと である。

【0145】アミン化合物: 下記シッフ塩基: 下記酢酸 トリフェニルスルホニウムが挙げられる。

【0146】特開平8-123030号記載の塩基性窒 素含有樹脂、特開平9-54437号記載の有機塩基性 化合物、特開平8-22120号記載のアミン化合物と 40 含窒素複素芳香環化合物、特開平8-211598号記 載のチオスルホネート化合物、特開平7-219217 号記載の加熱中性化塩基性化合物:スルホニルヒドラジ ド化合物など、なお加熱中性化塩基性化合物を使用する 場合は露光後現像処理する前に加熱 (ポストベイク) す ることで感度が大幅に向上する。

【0147】プロトン (H+) を捕捉可能な化合物であ

58 れば上記に示した化合物以外でも制約無しに使用するこ とが可能である。

【0148】これらの、塩基性化合物は単独又は2種以 上組み合わせて用いてもよい。使用量は感光層中に0. 001~10重量%が好ましく、0.01~5重量%が より好ましい。0.001以下では保存安定性向上、露 光後経時小点再現性低下抑制の効果がなく、10重量% 以上では感度低下が著しい。

【0149】アミン化合物は、具体的には、メチルアミ ン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、nープロピル アミン、ジーnープロピルアミン、トリーnープロピル アミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソ ブチルアミン、secーブチルアミン、tertーブチ ルアミン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミン、α フェニルエチルアミン、β-フェニルエチルアミン、 エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメ チレンジアミン、水酸化テトラメチルアンモニウム、ア ニリン、メチルアニリン、ジメチルアニリン、ジフェニ 20 ルアミン、トリフェニルアミン、o-トルイジン、m-トルイジン、pートルイジン、oーアニシジン、mーア ニシジン、pーアニシジン、oークロルアニリン、mー クロルアニリン、pークロルアニリン、oープロムアニ リン、mーブロムアニリン、pーブロムアニリン、oー ニトロアニリン、mーニトロアニリン、pーニトロアニ リン、2、4ージニトロアニリン、2、4、6ートリニ トロアニリン、oーフェニレンジアミン、mーフェニレ ンジアミン、pーフェニレンジアミン、ベンジジン、p -アミノ安息香酸、 スルファニル酸、 スルファニルアミ 30 ド、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、ピペリジ ン、ピペラジン、尿素などが挙げられる。

【0150】シッフ塩基は、具体的には一般式 [0151]

【化27】

$$R_3 = N - R_2$$

[但し、R1、R2 は炭化水素基(例えばメチル基、イ ソピロピル基、オクチル基、ヘプタデシル基等のアルキ ル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基等のシクロア ルキル基、フェニル基、トリル基等のアリール基など で示される化合物が挙げられ、具体例として下記が挙げ

[0152]

【化28】

No.1 
$$^{59}$$
 CH = N  $^{-}$  OCH<sub>3</sub>

No.2 
$$CH_9O$$
— $CH = N$ — $C_4H_9$ 

No.3 
$$C_2H_5O$$
— $CH = N$ — $C_4H_6$ 

$$CH_{3} \xrightarrow{C} H = N \xrightarrow{H} N = C$$

No.5 
$$CH = N N = CH$$

No.6 
$$\begin{array}{c|c} & H & CH_s \\ \hline & C - C - C - C = N \\ \hline & CH_s & H \end{array} N = C \\ \hline & CH_s & H \end{array}$$

【0153】これらフェノール成分の具体例としては、 (1) のフェノールとしてはフェノールの他カテコー ル、レゾルシン、ヒドロキノン、ピロガロール等の一 価、二価及び三価フェノールが挙げられるが、一価フェ ノールが好ましい。(2)のm-アルキルフェノールと しては、m-クレゾール、3,5-キシレノール、カル バクロール、チモール等が挙げられ、(3)のp-アル キルフェノールとしてはp-クレゾール、2,4-キシ レノール等が挙げられるが、これらは単独でも混合して も使用できる。しかしながら、フェノールとしては一価 のフェノールを95モル%以上含み、mーアルキルフェ ノールとしてはmークレゾールを95モル%以上含み、 又、p-アルキルフェノールとしてはp-クレゾールを\*50 ルエチルケトン等が挙げられる。

\* 95モル%以上含むものを使用するのが好ましい。 【0154】アルデヒド類としては、ホルムアルデヒ

40 ド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、アクロレイ ン、メタクロレイン、クロトンアルデヒド、アクロレイ ンジメチルアセタール、フルフラール等が挙げられる が、好ましいのはホルムアルデヒド又はベンズアルデヒ ドである。ホルムアルデヒドとしては、ホルムアルデヒ ド水溶液(ホルマリン)、ホルムアルデヒドのオリゴマ ーであるパラホルムアルデヒドを用いることができる。 特に37%ホルマリンが工業的に多量に生産されており 好都合である。

【0155】ケトン類としては、例えばアセトン、メチ

【0156】本発明のノボラック樹脂の製造法は、この 種反応に使用されている公知の方法、特にハイオルソノ ボラック樹脂を製造する方法を適宜適用することができ る。例えば、特公平4-2181号に示されているよう な特定の二価金属の有機酸塩を触媒に用い、pH4~7 の条件下で、m-/p-混合クレゾールを含むフェノー ル類をアルデヒドと付加縮合する方法、或いは二価金属 の有機酸塩を触媒としてフェノール類とアルデヒド類を 部分的に付加縮合した後、さらに酸を触媒に用いて付加 縮合する方法がある。

【0157】また、J. app1. Chem 1957 年、第676~688頁に記載されている通り、二価金 属の水酸化物又は酸化物を触媒に用いフェノール類をア ルデヒドと付加縮合する方法、或いは二価金属の水酸化 物又は酸化物を触媒としてフェノール類とアルデヒド類 を部分的に付加縮合した後、さらに酸を触媒に用いて付 加縮合する方法がある。また、m-/p-クレゾールを 所定の割合で混合して調整したフェノール類にホルマリ ン水溶液を添加し、トリエチルアミンを用いて縮合する 方法 (特開平3-253859号、特開平3-2538 20 60号)、フェノール類とパラホルムアルデヒドをトル エンのような非極性溶媒に溶解し、加圧条件下で高温に 加熱する方法等がある。ノボラック樹脂の製造にシュウ 酸等の酸触媒は広く使用されているが、ハイオルソノボ ラック樹脂の製造法により製造した樹脂は、通常のノボ ラック樹脂の製造法で得られた樹脂に比べ、前記X値は 高くなる傾向がある。本発明では、触媒として二価金属 の有機酸塩又は酸化物を使用する方法を適用するのが好 ましい。

【0158】本発明のノボラック樹脂は、この樹脂の重 30 水素化ジメチルスルホキシド溶液の1 3 C-NMRスペ クトルにおいて、23.0~31.0ppmまでのピー クの積分値をA、23.0~37.0ppmまでのピー クの積分値をBとした際に、X=A/Bの値がX≥0. 57であることを要件とする。

【0159】ここで、13C-NMRの測定は次の条件 で行う。JOEL製 EX-270型フーリエ変換核磁 気共鳴装置 (共鳴周波数 67.00MHz) を用い、 逆ゲーテッド・デカップリング法 (非NOEデカップリ ング測定)を適用する。測定温度は、22~24℃、パ 40 ルス幅6.8μs(約45度)、持ち時間3秒、観測周 波幅20000Hz、データポイント数33K、積算回 数4000回以上、基準はテトラメチルシランを0.0 ppmとする。

【0160】ここで規定する13C-NMRスペクトル のピークはいずれも芳香環同士のメチレン結合に帰属さ れるべきであり、上記ピーク比、X値は二つの異なる、 あるいは同じ環の、配置も含めた両者の特定の結合様式 に対応するものと解釈される。

ェノールとの混合ノボラック樹脂においては、この部分 のスペクトルは幅広く、多くのピークの混合からなって いる。その個々の帰属は未だ定かではなく、上記X値に 含まれる結合の様式には様々なものが含まれているが、 大略は、フェノールとアルキルフェノール同士が互いに オルソ位置で結合したものの割合に相関しているものと 思われる。

62

【0162】本発明のノボラック樹脂は、上記X値がX ≥0.57であるが、X≥0.60を満たすものがより 10 好ましい。

【0163】本発明のノボラック樹脂の重量平均分子量 Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (G PC)で測定したポリスチレン換算の表示を行ったとき に、3.0×10<sup>2</sup>~3.0×10<sup>4</sup>の範囲にあるのが 好ましく、特に1.0×10<sup>3</sup>~1.0×10<sup>4</sup>の範囲 にあるのが好ましい。一般に、3.0×102未満で は、成膜性に劣り、3.0×104を越えると感度が著 しく低下してしまう。

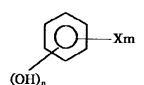
【0164】本発明のノボラック樹脂中における未反応 モノマー量は、5モル%以下、好ましくは2モル%以下 である。未反応モノマー量が5モル%を越えると、耐薬 品性が悪くなったり、あるいは印刷性能が低下する可能 性があるので好ましくない。 樹脂の未反応モノマー量を 2モル%以下にするために、例えば縮合反応後、減圧度 を高めることにより目的を達成することができる。

【0165】本発明の印刷版用感光性組成物 (感光層形 成時) におけるノボラック樹脂の占める割合は、通常5 ~80重量%であり、より好ましくは10~70重量% である。

【0166】アルカリ可溶性ノボラック樹脂として、m -クレゾール30~90モル%及び一般式(2) [0167]

【化29】

般式 (2)



[式中Xは-CH3、-C2H5、-C(CH3)3、 -CO<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> 又は-CO<sub>2</sub> C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> を意味し、3≥n ≥1、3≥m≥1である]で表される化合物 (但しm-クレゾールは除く) 70~10モル%を含むフェノール 類とホルムアルデヒドとを縮合させて得られ、かつ単分 散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロ マトグラフ(GPC)法により求めたポリスチレン換算 分子量が6300~25000、2500~6000及 び150~900の範囲にあるピークの最大の高さの値 【0161】しかし、現実にはフェノールとアルキルフ 50 をそれぞれa、b及びcとしたとき、 $a/b=0\sim1$ .

5及び $c/b=0.5\sim1.5$ の範囲にある樹脂を用いることを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物を提供するものである。

【0168】本発明の組成物においては、アルカリ可溶性ノボラック樹脂として、m-クレゾール30~90モル%及び前記一般式(2)の化合物30~90モル%を含むフェノール類とホルムアルデヒドとを縮合させて得られる樹脂が用いられる。

【0169】本発明に用いられる前記一般式(2)の化 合物としては、例えばoークレゾール、3,5-ジメチ 10 ルフェノール、2,5-ジメチルフェノール、2,3-ジメチルフェノール、2,4-ジメチルフェノール、 2,6ージメチルフェノール、3,4ージメチルフェノ  $-\mu$ , 2, 3, 5  $-\mu$ チルフェノール、2-t-ブチルフェノール、3-t-ブチルフェノール、2-メチルレゾルシノール、4-メ チルレゾルシノール、5ーメチルレゾルシノール、4ー t-ブテルカテコール、4-メトキシフェノール、3-メトキシフェノール、2-メトキシフェノール、2-メ トキシカテコール、2ーメトキシレゾルシノール、3ー メトキシレゾルシノール、2,3-ジメトキシフェノー ル、2、5ージメトキシフェノール、3、5ージメトキ シフェノール、没食子酸メチル、没食子酸エチル、3-メトキシー4,5ージヒドロキシ安息香酸メチル、3ー メトキシー4,5ージヒドロキシ安息香酸エチル、4ー メトキシー3、5ージヒドロキシ安息香酸メチル、4ー メトキシー3、5ージヒドロキシ安息香酸エチル、3、 4-ジメトキシー5-ヒドロキシ安息香酸メチル、3, 4ージメトキシー5ーヒドロキシ安息香酸エチル、3, 5-ジメトキシー4-ヒドロキシ安息香酸メチル、3. 5ージメトキシー4ーヒドロキシ安息香酸エチル、3ー エチルフェノール、2-エチルフェノール、4-エチル フェノール、2,3,5ートリエチルフェノール、3, 5-ジエチルフェノール、2,5-ジエチルフェノー ル、2,3-ジエチルフェノール等が挙げられる。これ らの化合物は単独で又は2種以上組み合わせて用いられ 8.

【0170】m-クレゾールと前記一般式(2)の化合物との使用割合(モル%)は、30~90/70~10である。

【0171】mークレゾール及び前記一般式(2)の化合物の使用割合が30モル%未満又は90モル%を越える場合には、解像度及び現像性が低下する。なお、この使用割合はノボラック樹脂合成時の原料の使用割合である。

【0172】また本発明に用いられるアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、東洋ソーダ製GPCカラム(G200 0H6 2本、G3000H6 1本、G4000H6

1本)を用い、流量1.5m1/分、溶出溶媒テトラ ましい。縮合反応終了後、系内に存在する未反応物、酸 ヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散 50 触媒及び反応媒質を除去するため、一般的には内温を1

64

ボリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフ (GPC) 法により求めたボリスチレン換算分子量が6300~25000、2500~6000及び150~900の範囲にあるピークの最大の高さの値をそれぞれa、b及びcとしたとき、a/b=0~1.5及びc/b=0.5~1.5の範囲にある樹脂である。このアルカリ可溶性ノボラック樹脂を用いることにより、従来のアルカリ可溶性ノボラック樹脂に比べ、解像度、感度、現像性、及び耐熱性に優れたものが得られる。

【0173】a/bの値が1.5を越える場合には、現像性及び感度が悪化する。又c/bの値が1.5を越える場合には、耐熱性が悪化し、c/bの値が0.5未満の場合には、感度及び解像度が低下する。

【0174】本発明に用いられるアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、前記フェノール類を酸触媒の存在下にホルムアルデヒドと縮合させて合成されるが、無触媒でも合成することができる。この際用いらる酸触媒としては、例えば塩酸、硝酸、硫酸等の無機酸、ギ酸、蓚酸、酢酸等の有機酸が挙げられる。ホルムアルデヒドの使用量はフェノール類1モルに対して0.7~3モル、酸触媒の使用量はフェノール類1モルに対して0~0.1モルが好ましい。

【0175】縮合反応においては、通常、反応触媒として水を用いるが、使用するフェノール類がホルムアルデヒドの水溶液に溶解せず、反応初期から不均一系になる場合には、反応媒質として親水性溶媒を使用することもできる。この際用いられる親水性触媒としては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、又はテトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテル類が挙げられる。

【0176】これらの反応媒質の使用量は、好ましくはフェノール類とホルムアルデヒドの総量100重量部当たり、20~1000重量部である。

【0177】縮合反応の反応温度は、フェノール類とホルムアルデヒドの反応性に応じて適宜調整することができるが、通常、10~200℃、好ましくは70~130℃である。又前記アルカリ可溶性ノボラック樹脂を得る反応法としては、例えば反応性の少ないフェノール類、ホルムアルデヒド及び酸触媒を一括して仕込んで反応させる方法、ホルムアルデヒド及び酸触媒にフェノール類を反応の進行とともに加えて反応させる方法等が学げられる。このフェノール類を反応の進行とともに加えて反応させる方法においては、前記アルカリ可溶性ノボラック樹脂をより再現性よく、安定的に製造するため、始めにフェノール類の一部、ホルムアルデヒド及び酸触媒を仕込んで重合させ、その後残りのフェノール類を反応の進行とともに加えて反応させる方法をとることが好ましい。縮合反応終了後、系内に存在する未反応物、酸

30~230℃に上昇させ、減圧下に揮発分を留去し、 次いで溶融したアルカリ可溶性ノボラック樹脂をスチー ル製ベルト等の上に流涎して、アルカリ可溶性ノボラッ ク樹脂を回収するが、溶剤に溶解させて回収する方法を とることもできる。

【0178】 芳香族アルデヒドとしては、下記一般式(3) に示すものを挙げることができる。

[0179]

【化30】

**一般式 (3)** 

「式中R4~R8は同一でも異なってもよく、水素原子、水酸基、ホルミル基、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基もしくはニトロ基を示す。但し、R4、~R8のうち少なくとも1つは水酸基であり、さらに残りの少なくとも1つはアルコキシ基である。〕一般式(3)のR4~R8において、ハロゲン原子としては塩素原子がより好ましい。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、n−ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基もしくはt−ブチル基のような炭

66

素数1~4のアルキル基が好ましく、メチル基が感度の点でより好ましい。シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘアチル基がより好ましい。アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基もしくはtーブトキシ基のような炭素数1~4のアルコキシ基が好ましく、

10 メトキシ基及びエトキシ基がより好ましい。アルケニル 基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基もしくは ブテニル基のような炭素数2~4のアルケニル基が好ま しく、ビニル基及びアリル基がより好ましい。アリール 基としてはフェニル基、キシリル基、トリイル基もしく はクメニル基が好ましく、フェニル基がより好ましい。 アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基もしく はクミル基が好ましく、ベンジル基がより好ましい。 【0180】但し、R4~R8のうち少なくとも1つは

日式中化4~R8は同一でも異なってもよく、水素原 子、水酸基、ホルミル基、ハロゲン原子、アルキル基、 シクロアルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリ 20 特に制限されない。更に残りの少なくとも1つはアルコール基、アラルキル基もしくはニトロ基を示す。但し、 R4、~R8のうち少なくとも1つは水酸基であり、さが好ましく、置換位置は特に制限されない。

【0181】一般式(3)で示される芳香族アルデヒド類のより具体的な例を以下に示すが、本発明において使用できる化合物はこれらに限定される訳ではない。

[0182]

【化31】

67 CHO 68 СНО ÇНО -ОМе ОМе OH (1) (2) (3) СНО СНО ĊНО ЮH ÓМе (4) (5) (6) СНО ĊНО СНО ÓН (7) (8) (9) СНО СНО СНО OH Оме όн (11) (10) (12) \*【化32】 СНО СНО СНО MeO ОМе ЮH (13) (14) (15) СНО СНО MeO. ОМе ОМе (16) (17)

[0184]

[0183]

※ ※【化33】

[0185]

EtO 
$$OEt$$
  $EtO$   $OEt$   $EtO$   $OEt$   $EtO$   $OEt$   $OET$ 

[0186]

\* \*【化35】

$$CH_2 = CH - CH_2$$
 OMe

(36)

ρн

**OMe** 

CHO

CHO OMe

(37)

ÓН

72

(38)

(39)

(40)

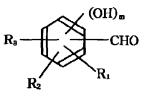
HO OHO OME

СНО

(41)

【0187】一般式(2)で示されるフェノール類と、ホルムアルデヒド、一般式(3)で示される芳香族アルデヒド類との混合比率は、本発明の効果を十分に発揮するために必要な量の芳香族アルデヒド類を用いればよく、特に制限されないが、(2)のフェノール類100モル%又は他のフェノール類を含む場合にはこれらフェノール類全体100モル%に対して芳香族アルデヒドは0.01~50モル%以下であることが好ましく、0.1~40モル%未満が更に好ましい。この範囲であると、感度の点で好ましい。

一般式 (4a)



【0190】[式中、R1~R3 は各々独立して水素原

子、炭素数1~6のアルキルもしくはアルケニル基又は

40 アリール基を表し、mはO、1、2又は3を表す。] あ

【0188】好ましい縮合物としては、下記一般式(4a)、(4b)で示される化合物を挙げることができる。

[0191]

るいは一般式 (4b)

【0189】 【化36】 【化37】

\*

一般式 (4b)

【0192】[式中、R1~R3は各々独立して水素原子、炭素数1~6のアルキルもしくはアルケニル基又は 10 アリール基を表す。k′は0、1又は2を表し、pは2 又は3を表す。]で示される芳香族アルデヒドを含むアルデヒド類とフェノール化合物とを酸触媒の存在下に反応させて得られる低分子量成分を単離せずに、さらにフェノール類及びホルムアルデヒドと縮合させて得られるノボラック樹脂、並びにローナフトキノンジアジド化合物を含むことを特徴とする感光性樹脂組成物である。

【0193】一般式(4a)及び(4b)で示される芳香族アルデヒドとして好ましくは、例えばベンズアルデヒド、4ーメチルベンズアルデヒド等のメチルベンズア 20ルデヒド類、テレフタルアルデヒド等のポリアルデヒド類、oー、mーもしくはpーヒドロキシベンズアルデヒド等のよりエーシベンズアルデヒド等のよりエーシベンズアルデヒド類が挙げられる。これらの芳香族アルデヒドは単独で、又は2種以上組み合わせて用いられる。又、アルデヒド類としては、上記一般式(4a)及び(4b)で示される芳香族アルデヒドと、ホルムアルデヒド以外の1種もしくは2種以上の脂肪族アルデヒド(例えばアセトアルデヒドもしくはグリオキサール等) 30との混合物を用いてもよい。

【0194】更に芳香族アルデヒドを含むアルデヒド類とフェノール化合物とを酸触媒の存在下に反応させて得られる低分子量成分を単離せずに、更にフェノール類及びホルムアルデヒドと縮合させて得られるノボラック樹脂として合成してもかまわない。

【0195】本発明の感光性組成物に含有されるナフトールノボラック化合物とは、ナフトール又はその誘導体をカルボニル化合物で縮合して得られるノボラック型化合物であり、例えば、下記に示す一般式(5)で表すこ 40とができる。

[0196]

【化38】

一般式 (5)

74

【0197】[式中、R¹及びR²は、同一であっても 異なっていてもよく、水素原子、置換もしくは非置換ア ルキル基、又は環状置換基であり、mは重合度を示す整 数である。ここで、mは15以下、R¹及びR²がアル キル基である場合、その炭素数は、1~10であること が好ましく、このアルキル基に導入され得る置換基とし ては、ハロゲン原子、カルボキシル基等が挙げられる。 更に、アルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、 ハロゲン原子等の置換基がナフタレン骨格に導入されて いてもよい。]

【0198】この化合物の原料の1つであるナフトール 誘導体とは、具体的には、少なくとも1つのヒドロキシ ル基が導入されたナフタレン骨格を有する化合物であっ て、一部の水素原子がメチル基などのアルキル基やハロ ゲン原子で置換された化合物を示す。なお、ヒドロキシ ル基が1つの場合、導入される位置は、ナフタレン骨格 のα位及びβ位のいずれでもよい。

【0199】また、カルボニル化合物としては、ホルム 30 アルデヒド、アセトアルデヒド、プロパノール、ブチラ ール、グリオキシル酸、アセトン、ブタノン、プロパノ ン、ペンタノン、ヘキサノン、ヘブタノン、オクタノ ン、ノナノン、デカノン及びそれらの環状化合物等が挙 げられる。さらに、ピシクロ化合物を使用することもで きる。

【0200】前述のナフトール又はその誘導体とカルボニル化合物との2種類の原料は、適宜選択して目的のナフトールノボラック化合物を得ることができるが、特に、カルボニル化合物を、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロパノール、ブチラール及びグリオキシル酸から選択し、このカルボニル化合物とナフトールとを使用することが好ましい。この場合には、合成が容易であるとともに、アルカリ溶解性及び溶解抑止能に優れたナフトールノボラック化合物を得ることができる。

【0201】こうしたナフトールノボラック化合物は、 具体的には、ナフトール又はその誘導体にカルボニル化 合物を加え、例えば、シュウ酸、硫酸、リン酸、又はオ キシ塩化2リンといった酸触媒等の作用によって縮合さ せて合成することができる。このとき、本発明に用いら

50 れるナフトールノボラック化合物は、通常、単量体から

十数量体の混合物として得られる。本発明において、ナ フトールノボラック化合物の分子量が2000以下に限 定される理由は、この範囲を逸脱すると、現像時の溶解 速度の低下を生じるおそれがあるからである。一方、ナ フトールノボラック化合物の分子量があまりに低いと、 その溶解抑止能や感光性組成物の塗布性が低下する傾向 があるため、ナフトールノボラック化合物の分子量は、 200~2000であることが好ましい。

【0202】このようなナフトールノボラック化合物 は、単独で用いても、あるいは2種類以上の混合物とし 10 て用いてもよい。

【0203】また、ナフトールノボラック化合物の配合 量は、感光性組成物の全固形分中、3wt%以上90w t%未満であることが好ましい。

### [0204]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0205】先ず、実施例、比較例に用いるノボラック 樹脂の合成について述べる。

「ハイオルソノボラックの合成(実施例1、2、3に対 20 応)]

### 製造例 1

300m1のセパラブルフラスコに、フェノール3.5 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38 (モル比) }、ホルマリン(37 %水溶液) 35.88g、酢酸亜鉛二水和物0.80g を仕込み110℃の油浴で1時間加熱攪拌し反応させ、 生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。この樹脂のG 0であった。

### 【0206】製造例2

300mlのセパラブルフラスコに、メタクレゾール4 8g、パラクレゾール32g {メタクレゾール/パラク レゾール=6/4 (モル比) }、ホルマリン33.78 gを用いた以外は製造例1合成条件と同様にしてノボラ ック樹脂を合成した。この樹脂のGPCクロマトグラフ ィーによる重量平均分子量は3700であった。

#### 【0207】製造例3

300mlのセパラブルフラスコに、フェノール10 g、4-オクチルフェノールノボラック87.65g **{フェノール/4ーオクチルフェノールノボラック=2** /8(モル比)}、ホルマリン33.78gを用いた以 外は製造例1合成条件と同様にしてノボラック樹脂を合 成した。この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重 量平均分子量は3100であった。

【0208】 「ハイオルソノボラックの合成(低分子ハ イオルソノボラック+再度共縮合) (実施例4に対 応)]

## 製造例4

76

300mlのセパラブルフラスコに、メタクレゾール4 8g、パラクレゾール32g {メタクレゾール/パラク レゾール=6/4 (モル比) }、ホルマリン19.28 gを用いた以外は製造例1合成条件と同様にしてノボラ ック樹脂を合成した。(このときの樹脂のGPCクロマ トグラフィーによる重量平均分子量は900であった) その反応終了後、再度ホルマリン19.28gを用いフ ェノール5gを仕込み110℃の油浴で1時間加熱攪拌 し反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。 この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平均分 子量は7000であった。

【0209】 [タンデム型ノボラックの合成(請求項5 に対応)]

#### 製造例5

500mlのセパラブルフラスコに、メタクレゾール4 8g、パラクレゾール32g (メタクレゾール/パラク レゾール=6/4 (モル比) }、ホルマリン52.28 g及び蓚酸0.01gを仕込み110℃の油浴で1時間 加熱撹拌し反応させ、その後更にメタクレゾール48 g、及びパラクレゾール32g {メタクレゾール/パラ クレゾール=6/4 (モル比) } を反応の進行と共に連 続的にセパラブルフラスコに仕込み、2時間反応させ た。次いで油浴温度を180℃まで上昇させ減圧下で 水、ホルムアルデヒド、未反応のメタクレゾール、パラ クレゾール及び蓚酸を除去させた。次いで溶融したノボ ラックを室温まで戻し回収した。この樹脂のGPCクロ マトグラフィーによる重量平均分子量は評価表に示す。 【0210】製造例6

500mlのセパラブルフラスコに、メタクレゾール2 PCクロマトグラフィーによる重量平均分子量は450 30 1.6g、4-t-ブチルフェノール30.0g (メタ クレゾール/ブチルフェノール=6/4(モル比)}、 ホルマリン77.0g及び蓚酸0.01gを仕込み11 0℃の油浴 (内温100℃) で1時間加熱攪拌し反応さ せ、その後更にメタクレゾール21.6g、4-t-ブ チルフェノール30.0g (メタクレゾール/ブチルフ ェノール=6/4 (モル比) } を反応の進行と共に連続 的にセパラブルフラスコに仕込み、2時間反応させた。 次いで油浴温度を180℃まで上昇させ減圧下で水、ホ ルムアルデヒド、未反応のメタクレゾール、パラクレゾ 40 一ル及び蓚酸を除去させた。次いで溶融したノボラック を室温まで戻し回収した。この樹脂のGPCクロマトグ ラフィーによる重量平均分子量は評価表に示す。

### 【0211】製造例7

500m1のセパラブルフラスコに、メタクレゾール3 2. 4g、3, 5-ジメチルフェノール24. 4g {メ タクレゾール/3,5ージメチルフェノール=6/4 (モル比) }、ホルマリン77.0g及び蓚酸0.08 gを仕込み110℃の油浴(内温100℃)で1時間加 熱攪拌し反応させ、その後更にメタクレゾール21.6

50 g、4-t-ブチルフェノール30.0g {メタクレゾ

ール/ブチルフェノール=6/4 (モル比) } を反応の 進行と共に連続的にセパラブルフラスコに仕込み、2時 間反応させた。次いで油浴温度を180℃まで上昇させ 減圧下で水、ホルムアルデヒド、未反応のメタクレゾー ル、パラクレゾール及び蓚酸を除去させた。次いで溶融 したノボラックを室温まで戻し回収した。この樹脂のG PCクロマトグラフィーによる重量平均分子量は評価表

【0212】 [芳香族アルデヒド縮合ノボラックの合成 (請求項6、7、8に対応)]

#### 製造例8

300m1のセパラブルフラスコに、フェノール3.5 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38 (モル比) }、サリチルアルデヒ ド12.96gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪 拌し反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得 た。この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平 均分子量は3000であった。

### 【0213】製造例9

300mlのセパラブルフラスコに、フェノール3.5 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38(モル比)}、ベンズアルデヒド 11.26gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪拌 し反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。 この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平均分 子量は3000であった。

# 【0214】製造例10

g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38(モル比)}、2ーヒドロキシー 4-メトキシベンズアルデヒド30.43gを仕込み1 10℃の油浴で3時間加熱攪拌し反応させ、生成物を乾 燥してノボラック樹脂を得た。この樹脂のGPCクロマ トグラフィーによる重量平均分子量は5300であっ た。

# 【0215】製造例11

300mlのセパラブルフラスコに、フェノール3.5 40 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38(モル比)}、ホルムアルデヒド (37%水溶液) 32.12 gとベンズアルデヒド3 43gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪拌し 反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。こ の樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平均分子 量は4700であった。

### 【0216】製造例12

g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3  $0.56g{7ェノール/メタクレゾール/パラクレゾ$ ール=5/57/38 (モル比) }、テレフタルアルデ ヒド13.4gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪 拌し反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得 た。この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平 均分子量は4900であった。

78

【0217】[ナフトールノボラックの合成(請求項9 ~10に対応)]

### 10 製造例13

300mlのセパラブルフラスコに、αーナフトール7 2.1g、ホルムアルデヒド(37%水溶液)20.3 gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪拌し反応さ せ、減圧生成し、残留モノマー除去してナフトールノボ ラック樹脂を得た。この樹脂のGPCクロマトグラフィ ーによる重量平均分子量は660であった。

### 【0218】製造例14

300mlのセパラブルフラスコに、αーナフトール7 2. 1g、2-アダマンタノン37. 56g、エチルセ 20 ロソルブ50m1を仕込みオキシ塩化2機3gを加え1 10℃の油浴で3時間加熱攪拌し反応させ、減圧生成 し、残留モノマーを除去してナフトールノボラック樹脂 を得た。この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重 量平均分子量は350であった。

## 【0219】製造例15

300mlのセパラブルフラスコに、β-ナフトール7 2.1g、2-アダマンタノン37.56g、シクロへ キサノン50m1を仕込みオキシ塩化2燐3gを加え1 10℃の油浴で3時間加熱攪拌し反応させ、減圧生成 300mlのセパラブルフラスコに、フェノール3.5 30 し、残留モノマーを除去してナフトールノボラック樹脂 を得た。この樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重 量平均分子量は530であった。

# 【0220】 [比較例用ノボラック樹脂の合成法] 製造例16

300mlのセパラブルフラスコに、フェノール3.5 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38(モル比) }、ホルムアルデヒド 32. 1gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪拌し 反応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。こ の樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平均分子 量は3700であった。

#### 【0221】製造例17

300mlのセパラブルフラスコに、フェノール3.5 g、メタクレゾール45.84g、パラクレゾール3 0.56g {フェノール/メタクレゾール/パラクレゾ ール=5/57/38 (モル比) }、ホルムアルデヒド 9.2gを仕込み110℃の油浴で3時間加熱攪拌し反 応させ、生成物を乾燥してノボラック樹脂を得た。この 300m1のセパラブルフラスコに、フェノール3.5 50 樹脂のGPCクロマトグラフィーによる重量平均分子量

は200であった。

【0222】 [支持体の作成] 厚さ0.3 mmのアルミニウム板 (材質1050、調質H16)を65℃に保たれた5%水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処理を行った後水洗し、25℃に保たれた10%硫酸水溶液中に1分間浸漬し、中和し、更に水洗した。このアルミニウム板を1.0 wt%の硝酸水溶液中において、温度25℃、電流密度10A/dm²、処理時間60secの条件で交流電流により電解粗面化を行った。次いで、5%水酸化ナトリウム水溶液中で温度60℃、10秒間のデスマット処理を行い、その後、20%硫酸溶液中で温度20℃、電流密度3A/dm²、処理時間1分間の条件で陽極酸化処理を行った。その後、80℃に保たれた1%酢酸アンモニウム水溶液中に30秒間浸漬し、水洗後80℃で3分間乾燥した。更に、85℃に保たれたカル\*

\*ボキシメチルセルロース (CMCと略す) の水溶液 (濃度0.1wt%) に30秒浸漬した後、80℃で5分間 乾燥し、支持体を作成した。

【0223】 「酸分解化合物Aの合成」 1,1ージメトキシシクロヘキサノン(0.5モル)、フェニルセロソルブ(1.0モル)及びpートルエンスルホン酸80mgを混合し、攪拌させながら120℃で8時間反応させた。反応により生成するメタノール及び反応溶剤は反応終了後除去した。冷却後、水で洗浄し、水酸化ナトリウム溶液で洗浄し、その後中性になるまで飽和食塩水で洗浄し、得られた化合物を無水炭酸カリウムで脱水した後濃縮乾固して、目的の下記酸分解物Aの白色結晶を得た。

【0224】 【化39】

【0225】実施例1

※感光性組成物とした。

[感光組成物1の作成]以下に示すような割合で混合し※

バインダーB

製造例1(ハイオルソノボラック樹脂)

61.75重量部

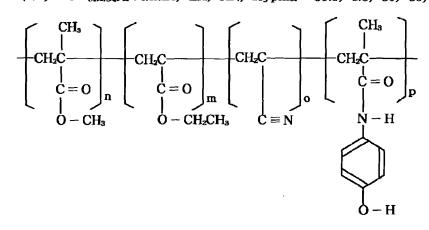
14重量部

[0226]

★ ★【化40】

バインダーB (組成比: MMA/EA/AN/Hypma = 36.5/3.5/30/30)

分子量;38000



MMA

EA

AN

Hypma

[0227]

酸分解物A20重量部酸発生剤 (前記例示のA)3重量部シアニン色素 (前記例示のIR25化合物)1重量部界面活性剤 (旭硝子S-381)0.25重量部溶剤 (PGM/MEK=7/3)1000重量部

【0228】前記作成した支持体上に上記組成の感光層☆50☆塗布液を乾燥後膜厚が2.0g/m² になるようにワイ

ヤーバー塗布を行い、95℃で90秒間乾燥して画像形 成材料を得た。

【0229】得られた感光性平版印刷版を、半導体レー ザー (波長830nm、出力500mw)で画像露光を 行った。レーザー光径はピークにおける強度の1/e2 で13µmであった。又、解像度は走査方向、副走査方 向とも2000dpiとした。画像露光の後、コニカp s 阪用現像液 SDR-1 (コニカ社製) /水=1/5で 希釈した。その後30℃に保った現像液に30秒間浸漬 し現像を行った後水洗乾燥を行った。この際、非画線部 10 比較を目視にて評価を行った。 (露光部)を除去しポジ型画像を形成する。

### 【0230】感度評価

上記条件において、露光部が現像されるのに必要な露光 エネルギー (mj/cm²)で評価した。

#### 【0231】現像ラチチュード

上記感度にて画像形成したサンプルを、現像液の希釈条 件をSDR-1/水=1/3,1/5(通常条件),1 /9とし上記同様な現像条件で現像し、非画線部の感度\*

実施例2

「感光組成物2の作成」

製造例1(ハイオルソノボラック樹脂) 酸架橋型樹脂:ヘキサメトキシメチルメラミン

酸発生剤(前記例示のA)

シアニン色素(前記例示のIR25化合物)

界面活性剤(旭硝子S-381)

溶剤 (PGM/MEK=7/3)

【0234】前記作成した支持体上に上記組成の感光層 塗布液を乾燥後膜厚が2.0g/m²になるようにワイ ヤーバー塗布を行い、95℃で90秒間乾燥して画像形 成材料を得た。

【0235】得られた感光性平版印刷版を、半導体レー ザー (波長830nm、出力500mw)で画像露光を 行った。レーザー光径はピークにおける強度の1/e2 で13µmであった。又、解像度は走査方向、副走査方 向とも2000dpiとした。画像露光の後、コニカp s版用現像液SDR-1 (コニカ社製) / 水=1/5で 希釈した。その後30℃に保った現像液に30秒間浸漬 し現像を行った後水洗乾燥を行った。この際、非画線部 (未露光部)を除去しネガ型画像を形成する。

#### 【0236】 慰度評価

上記条件において、露光部が現像されるのに必要な露光 エネルギー (mj/cm²)で評価した。

【0237】現像ラチチュード

上記感度にて画像形成したサンプルを、現像液の希釈条 件をSDR-1/水=1/3,1/5(通常条件),1 /9とし上記同様な現像条件で現像し、非画線部の感度※

実施例3

[感光組成物1の作成]

以下に示すような割合で混合し感光性組成物とした

製造例1 (ハイオルソノボラック樹脂)

82

\*及び地汚れを評価した。 判定基準

〇:非画線部が汚れない。問題なし。

△: 非画線部が若干汚れる。

×: 非画線部が汚れる。

【0232】耐薬品性

上記、感度評価画像により得られた画像を、ウルトラプ レートクリーナー(大日精化社製)の原液に15分、3 0分、60分間浸漬させ、水洗し、浸漬前の画像部との

判定基準

〇:画像部の侵食がない。

△:画像部の侵食が僅かに有り、感光層下の支持体の砂 目がやや露出。

×: 画像部の侵食が著しく、感光層下の支持体の砂目が 完全に露出。

[0233]

2重量部

0.25重量部 1000重量部

74.75重量部

20重量部

3重量部

※及び地汚れを評価した。

判定基準

〇: 非画線部が汚れない。問題なし。

30 △: 非画線部が若干汚れる。

×: 非画線部が汚れる。

【0238】耐薬品性

上記、感度評価画像により得られた画像を、ウルトラブ レートクリーナー (大日精化社製)の原液に15分、3 0分、60分間浸漬させ、水洗し、浸漬前の画像部との 比較を目視にて評価を行った。

判定基準

○: 画像部の侵食がない。

△: 画像部の侵食が僅かに有り、感光層下の支持体の砂

40 目がやや露出。

×: 画像部の侵食が著しく、感光層下の支持体の砂目が 完全に露出。

それ以外の実施例、比較例は表(評価表、別紙化合物表 参照)の通りに実施した。

[0239]

75.75重量部

酸分解物A

酸発生剤(前記例示のA)

シアニン色素(前記例示のIR25化合物)

界面活件剤(旭硝子S-381)

溶剤 (PGM/MEK=7/3)

84

20重量部

3重量部 1重量部

0.25重量部

\*/9とし上記同様な現像条件で現像し、非画線部の感度

1000重量部

【0240】前記作成した支持体上に上記組成の感光層 塗布液を乾燥後膜厚が2.0g/m²になるようにワイ ヤーバー塗布を行い、95℃で90秒間乾燥して画像形 成材料を得た。

【0241】得られた感光性平版印刷版を、半導体レー 10 △:非画線部が若干汚れる。 ザー (波長830 nm、出力500mw) で画像露光を 行った。レーザー光径はピークにおける強度の1/e2 で13μmであった。又、解像度は走査方向、副走査方 向とも2000dpiとした。 画像露光の後、コニカp s版用現像液SDR-1 (コニカ製) / 水=1/5で希 釈した。その後30℃に保った現像液に30秒間浸漬し 現像を行った後水洗乾燥を行った。この際、非画線部 (露光部)を除去しポジ型画像を形成する。

#### 【0242】 感度評価

上記条件において、露光部が現像されるのに必要な露光 20 目がやや露出。 エネルギー (mj/cm²)で評価した。

【0243】現像ラチチュード

上記感度にて画像形成したサンプルを、現像液の希釈条 件をSDR-1/水=1/3, 1/5 (通常条件), 1\*

## 実施例4

[感光組成物2の作成]

製造例1(ハイオルソノボラック樹脂)

54.75重量部

40重量部

3重量部

酸架橋型樹脂: (СКР-918 メチロール基含有レゾール樹脂:

昭和高分子)

酸発生剤(前記例示のA)

シアニン色素 (前記例示の IR25化合物)

界面活性剤(旭硝子S-381)

溶剤(PGM/MEK=7/3)

【0246】前記作成した支持体上に上記組成の感光層 塗布液を乾燥後膜厚が2.0g/m²になるようにワイ ヤーバー塗布を行い、95℃で90秒間乾燥して画像形 成材料を得た。

【0247】得られた感光性平版印刷版を、半導体レー ザー (波長830nm、出力500mw)で画像露光を 行った。レーザー光径はピークにおける強度の1/e2 40 △: 非画線部が若干汚れる。 で13µmであった。又、解像度は走査方向、副走査方 向とも2000dpiとした。画像露光の後、コニカp s版用現像液SDR-1 (コニカ社製) /水=1/5で 希釈した。その後30℃に保った現像液に30秒間浸漬 し現像を行った後水洗乾燥を行った。この際、非画線部 (未露光部)を除去しネガ型画像を形成する。

#### 【0248】感度評価

上記条件において、露光部が現像されるのに必要な露光 エネルギー (mj/cm²)で評価した。

【0249】現像ラチチュード

判定基準 〇: 非画線部が汚れない。問題なし。

及び地汚れを評価した。

×: 非面線部が汚れる。

【0244】耐薬品性

上記、感度評価画像により得られた画像を、ウルトラプ レートクリーナー (大日精化社製)の原液に15分、3 0分、60分間浸漬させ、水洗し、浸漬前の画像部との 比較を目視にて評価を行った。

#### 判定基準

〇:画像部の侵食がない。

△: 画像部の侵食が僅かに有り、感光層下の支持体の砂

×:画像部の侵食が著しく、感光層下の支持体の砂目が 完全に露出。

[0245]

2重量部 0.25重量部 1000重量部

※上記感度にて画像形成したサンプルを、現像液の希釈条 件をSDR-1/水=1/3,1/5(通常条件),1 /9とし上記同様な現像条件で現像し、非画線部の感度 及び地汚れを評価した。

## 判定基準

〇: 非画線部が汚れない。問題なし。

×: 非画線部が汚れる。

【0250】耐薬品性

上記、感度評価画像により得られた画像を、ウルトラブ レートクリーナー (大日精化社製) の原液に15分、3 0分、60分間浸漬させ、水洗し、浸漬前の画像部との 比較を目視にて評価を行った。

#### 判定基準

○: 画像部の侵食がない。

△: 画像部の侵食が僅かに有り、感光層下の支持体の砂 ※50 目がやや露出。

×: 画像部の侵食が著しく、感光層下の支持体の砂目が \*る。

完全に露出。

[0251]

それ以外の実施例、比較例は表1~表5に示す通りであ\* 【表1】

: :	ABUNO.	利明No. /ギラが書館	ti,	梅寿現像(1974)をあるな(1974)	(8)	現像液分かり、	5	<b>参訂条件 (1 /0)</b>	6	<b>孙罗蒙耀</b>	製業品性(UPOM性)	
			•	<u> </u>	本画筆的た	(20/107) 新華	(11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	(m)/m2)	一帯回雑形九	30min	45min	60min
	工作例1	1	0.69	350	0	950	0	300	0	0	0	6
<b>林衛教</b>	奖制例2	1	0.60	150	0	100	0	951	0	0	40	a
<b>東</b> 校型1、2、3	其所例3	1	69'0	100	0	R	0	051	0	0	0	0
	实施例4	1	0.69	150	0	100	0	200	0	0	0	0
	英格例	7	0.77	200	0	150	0	200	0	0	0	0
	实施例6	2	0.77	150	0	100	0	150	0	0	1	8
	美瓶例7	2	0.77	200	0	150	0	200	0	0	1	0
	实施例8	2	0.77	150	0	100	0	051	0	0	1	0
	发素例9	C	0.81	300	0	200	0	300	0	0	١	6
,	<b>外施护</b> 10	3	0.81	250	0	150	0	52	0	0	1	8
	英桅例11	3	0.81	200	0	SSS	0	250	0	o	1	0
	美施例12	3	0.81	150	0	150	0	250	0	0	1	0
	比較例	36	0.65	400	0	400	0	07×	0	₫		×
	比較例2	16	0.65	250	0	150	0	300	0	×	×	×
	打眾室3	16	0.65	200	0	200	0	002	0	0		×
	打器定	16	6,65	150	0	150	0	150	0	0	4	┛
	比較例S	17	0.62	( , v )	₩.v.	(1)	∰^*ij	( . V.	( • V.)	×		×
	力数更多	17	0.62	<b>∭</b> ^*y	課かり	調べり	(1,4)	( <b>)</b>	(*)	×		×
	打数空7	17	0.62	J∰N*")	臓ページ	( )	£v.∌	(Mr. 1)	(*)種	×	×	×
	<b>计数例8</b>	17	0.62	最小"リ	酸小り	(LV)	(1.)	<b>臓へ</b> "リ	しゃり	×	×	×
	开表室	1.439°-B	0.96	>400	×	>400	×	<b>X</b>	×	0	0	0
	开政党10	N. (2)" B	<b>98</b> .0	>400	×	>400	×	>400	×	0	0	0
	比較到11		96'0	×400	×	>400	×	2400	×	0		0
	<b>比較例12</b>	A・4/ゲー日	0.58	>400	×	>400	×	>400	×	0		0

結果(糖水項1、

[0252]

※ ※【表2】

Э.	O	
Э.	0	

話果(觀2	(糖水頃4)			¥	AT YOUR REEL YES							
	A MENO	発明No. /#*5か樹脂		基件证券 (Ref.)		一直の音楽がして		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3	耐集品性(UPC耐性)	UPCER	
			<b>1</b>	格敦政策(17 縣縣 (m)/m2)	中国権治れ	格女代年(1/3)   格徴 (m]/m3)  非同様厄む	の一部関係的な	施契保年(1~8)  原展(10~2)  岩屋雑節七	a) 非国義形九	30min	45min	60min
	<b>美術型</b>		0.74	202		920	•	82	0	0	0	6
は様子	黄栀柳2	-	0.74	<u>8</u>	0	8	0	150	0	0	0	4
都水道へ	質集例3	4	0.74	130	0	훒	0	92	0	0	0	VO
	美馬利4	+	0.74	150	0	051	0	150	0	0	Γ	0
	質能與多	4/16-8/2	0.740.65	150	0	150	0	150	0	0		0
	資施金6	4/16-8/2	0.74,0.65	100	0	81	0	130	0	0		<b>√</b> 0
	実施例7	416-8/2	0.74/0.65	150	0	150	0	200	0	0	Ĭ	0
	実施例。	4/16=6/2		150	0	100	0	250	0	0	0	0
	上数例1	16	59'0	400	0	400	0	>400	0	V	×	×
	上版例2	16		250	0	150	0	300	0	×	×	×
	开载着	16	\$970	200		200	0	200	0	0	4	×
	万数章	16		150		150		150	0	0	4	4
	开版 數S	17		n.viii		(LV)	L	(LV)	( . V)	×	×	×
*	比較例6	17	0.62	n, Mil	(.W	(・)瀬	行・ソ政	ń.√M	(, <b>v</b> )	×	×	×
	比較例7	17	0.62	í, <b>√á</b> í	· .v.	(LV)	(1.VE)	f.v.n	( , V	×	×	×
	<b>比較例8</b>	17	0.62	₩v,n	í,√∰	() ()	1.V	( <b>)</b>	(. <b>M</b> ()	×	×	×
	九京全9	1.49°-18	0.98	×400	×	>400	×	>400	×	0		0
	<b>元款</b> 例10		0.96	>400	×	>400	×	>400	×	0		0
	比較例11		0.98	×400	×	) <del>(</del>	×	2400	×	0	0	0
	上的例12	1.4/7.4 B	0.98	ÇÇX	×	<b>1</b>	×	WP%	×	C	Γ	c

[0253]

\* \*【表3】

が歴史	報告ない 一年を発見しており	_	である。		_ ;	和原語のチャート		4	;	(世間ので)世間第四		Đ.
		# \$	8	神気保存(1/6)   梅貫(8752)  赤西神応亡	の)を開業形式	<b>おきな</b> 年(17) ・	(で)  一次回番油汁	を表表す(1)を表現の(1)を表現	係年(1/2) (4/1/4) 岩関建治(40年)		A.S.	60min
英属例1		<b>25</b> T)	900	S	b	250			b	0	6	
東橋河2	-	33	89	ន្ត	0	250	0	ន្ត	0	0		0
N N	8	850	000	SE SE	0	202	0	82	0	0	0	0
大学学	<b>~</b>	853	000	g	0	230	0	902	0	0	0	0
発験が	9	707	0,42	<b>5</b> 7	0	250	0	300	0	0	0	0
W 4 4 4	9	101	0.42	88	0	150	0	300	٥	0	0	80
海龍河7	9	101	0.42	200	0	150	٥	200	٥	0	o	0
大学学	9	101	0.42	051	0	051	0	300	0	0	0	0
の変異が	7	3	86.0	98	þ	906	0	\$	6	0	0	<b>V</b> O
<b>資本資</b> 10		101	0.90	81	0	150	0	250	0	0	4	   
別類型11	4	101	0.90	000	0	200	0	200	0	0	0	0
实施例12	7	101	0,90	150	0	150	0	200	0	0	0	0
压解到1	97	Ī	0.02	90	0	007	0	>400	0	7	×	×
九年第2	Ц	1	0.02	250	0	150	0	300	0	×	×	×
日本書		I	0.02	200	٥	200	0	200	0	0	٧	×
五教章	Ц	1	0.02	150	0	150	٥	150	0	0		ᅒ
元表表	17	2511	212.1	1.4	√ ✓	<b>6.∨臓</b>	んが着	₩.v.	6.VM	×		×
五款产6	17	25'0	212,1	<b>第</b> 4.9	n.vam	í,√il	h.v.iii	₩.v.y	6,4	×	×	×
元数型	17	<b>787</b>	212.1	1.V#	ſ. <b>∀</b> #	f.√ <b>%</b>	1.VM	₩v.ñ	6,1/2	×	×	×
五款 98	17.	<b>25</b> '0	212.1	£4.0	ſ.V	が、1	f.vai	ñ.v.ñ	£,√	×	×	×
九载沙		1	1	₩ 200	×	00 <del>1</del> ×	×	>400	×	0	0	0
<b>比較例</b> 10		I	1	₩	×	O0 <del>1</del> ×	×	×400	×	0	0	0
五数第11	┝	1	J	×400	×	97	×	00 <del>1</del> ×	×	0	0	0
14.00	Ļ			,			,			4	k	

結果(請求項5)

[0254]

3
3
*

8

(超长屋 6、

酤果

91

所集品格(UPC開程) 海線能5/打工・ 本配条件 (1/3) 本配条件 (1/3) 350 (a.Jun.2) 評価銀行れ 350 (0.00 200 (0.00 300 (0.00 300 (0.00 300 (0.00 300 (0.00 200 (0.00 300 (0.00 200 (0.00 

\* \*【表5】

[0255]

Sonta Sonta 配業品性(UPCINE **40** 30min 希釈条件(1/9) 楊度 (山/加2) |非面線汚れ 春聚条件(1/3) 楊度 (m/m2) |非国線汚れ /4'5%結果表XLS 8 8 8 / 5) |李暦線汚れ 標準現像 (Ref) 希釈条件(1/ 概度 (四/m2) | 1 13/16=3/7 13/16=3/7 (離水頃 8、10) 编型No. **本的母** 翻求與 8、10 <del>紅</del>栗

[0256]

\* ラチチュード性の向上及び高感度性を有する感光性組成 物を提供することができる。

【発明の効果】本発明によれば、耐薬品性向上、現像液\*